Deutscher Bundestag
11. Wahlperiode

Drucksache 11/454

09. 06. 87

Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Halbleiterschutzgesetz)

A. Zielsetzung

Der Entwurf dient der Umsetzung der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 16. Dezember 1986 über den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen (87/54/EWG), die den rechtlichen Rahmen der Gemeinschaft für den Schutz gegen das unrechtmäßige Kopieren von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen, sog. Mikro-Chips, schafft. Zur Erhaltung von Innovationskraft und Investitionsbereitschaft der Halbleiterindustrie ist ein derartiger Kopierschutz erforderlich. Das Gesetz muß spätestens am 7. November 1987 in Kraft treten.

B. Lösung

Der Entwurf sieht ein neues gewerbliches Schutzrecht sui generis vor, das Elemente des urheberrechtlichen Schutzes mit solchen gewerblicher Schutzrechte verbindet. Wie bei den übrigen gewerblichen Schutzrechten ist insbesondere eine zentrale Registrierung beim Deutschen Patentamt vorgesehen. Die Schutzdauer soll zehn Kalenderjahre nach dem Jahr des Schutzbeginns betragen. Der Schutz soll mit der erstmaligen geschäftlichen Verwertung der Topographie (dreidimensionale Struktur des Mikro-Chips) oder mit dem Antrag auf Eintragung beim Deutschen Patentamt entstehen, wobei der frühere der beiden Zeitpunkte maßgebend ist. Der Schutz soll nur geltend gemacht werden können, wenn die Topographie spätestens zwei Jahre nach deren geschäftlicher Verwertung beim Deutschen Patentamt angemeldet worden ist. Das neue Schutzrecht soll — abweichend vom Patent- und Gebrauchsmusterrecht —, ähnlich wie das Urheberrecht, lediglich die Wirkung eines Nachbildungs- und Verwertungsverbots haben. Die Verwertung einer im Wege der Analyse einer geschützten Topographie hergestellten neuen Topographie (sogenanntes reverse engineer-

ing) soll vom Schutzrecht nicht erfaßt werden. Im übrigen orientiert sich das Schutzrecht eng am Gebrauchsmusterrecht. Zusätzlich sind die notwendigen Änderungen in anderen Gesetzen vorgesehen.

C. Alternativen

keine

D. Kosten

Das Gesetz wird sich geringfügig auf den Bundeshaushalt auswirken. Infolge der Schaffung des neuen Schutzrechts werden sich bei in etwa zu erwartenden 500 Anmeldungen pro Jahr und einer Pauschalgebühr in Höhe von 500 DM pro Anmeldung zusätzliche Einnahmen beim Deutschen Patentamt in Höhe von 250 000 DM pro Jahr ergeben. Mehrausgaben werden bei der Festlegung einer Gebühr in dieser Höhe nicht entstehen, vgl. Bemerkungen in der Begründung unter A. VII.

Durch die Ausführung des Gesetzes entstehen für die Länder und Gemeinden keine zusätzlichen Kosten.

Bundesrepublik Deutschland
Der Bundeskanzler
121 (131) — 421 04 — Ha 1/87

Bonn, den 9. Juni 1987

An den Herrn
Präsidenten des Deutschen Bundestages

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines Gesetzes über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Halbleiterschutzgesetz) mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt.

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.

Federführend ist der Bundesminister der Justiz.

Der Bundesrat, dem die Vorlage am 15. Mai 1987 als besonders eilbedürftig zugeleitet wurde, hat in seiner 577. Sitzung am 5. Juni 1987 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus der Anlage 2 ersichtlich, Stellung zu nehmen.

Die Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates wird unverzüglich nachgereicht.

Kohl

Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Halbleiterschutzgesetz)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

ERSTER ABSCHNITT

Der Schutz der Topographien

§ 1

Schutzgegenstand, Eigenart

(1) Dreidimensionale Strukturen von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Topographien) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes geschützt, wenn und soweit sie Eigenart aufweisen. Satz 1 ist auch auf selbständig verwertbare Teile sowie Darstellungen zur Herstellung von Topographien anzuwenden.

(2) Eine Topographie weist Eigenart auf, wenn sie als Ergebnis geistiger Arbeit nicht nur durch bloße Nachbildung einer anderen Topographie hergestellt und nicht alltäglich ist.

(3) Besteht eine Topographie aus einer Anordnung alltäglicher Teile, so wird sie insoweit geschützt, als die Anordnung in ihrer Gesamtheit Eigenart aufweist.

(4) Der Schutz nach Absatz 1 erstreckt sich nicht auf die der Topographie zugrundeliegenden Entwürfe, Verfahren, Systeme, Techniken oder auf die in einem mikroelektronischen Halbleitererzeugnis gespeicherten Informationen, sondern nur auf die Topographie als solche.

§ 2

Recht auf den Schutz

(1) Das Recht auf den Schutz der Topographie steht demjenigen zu, der die Topographie geschaffen hat. Haben mehrere gemeinsam eine Topographie geschaffen, steht ihnen das Recht gemeinschaftlich zu.

(2) Ist die Topographie im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses oder im Auftrag eines anderen geschaffen worden, so steht das Recht auf den Schutz der Topographie dem Arbeitgeber oder dem Auftraggeber zu, soweit durch Vertrag nichts anderes bestimmt ist.

(3) Inhaber des Rechts auf den Schutz der Topographie nach den Absätzen 1 und 2 kann jeder Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sowie jede natürliche oder juristische Person sein, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder eine Niederlassung in dem Gebiet eines Mitgliedstaates hat, in dem der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gilt; den juristischen Personen sind Gesellschaften gleichgestellt, die nach dem auf sie anwendbaren Recht Träger von Rechten und Pflichten sein können, ohne juristische Personen zu sein.

(4) Das Recht auf den Schutz der Topographie steht unbeschadet der Absätze 1 und 2 auch demjenigen zu, der die Topographie erstmals in einem Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft nicht nur vertraulich geschäftlich verwertet, sofern er hierfür das ausschließliche Recht hat und die Voraussetzungen des Absatzes 3 erfüllt. Die Topographie darf noch nicht zuvor von einem anderen nicht nur vertraulich geschäftlich verwertet worden sein.

(5) Die Rechte nach den Absätzen 1 bis 4 stehen auch den jeweiligen Rechtsnachfolgern zu.

(6) Anderen Personen steht ein Recht auf den Schutz der Topographie nur zu, wenn

1. sie aufgrund einer völkerrechtlichen Vereinbarung oder des Rechts der Europäischen Gemeinschaften wie Inländer zu behandeln sind oder
2. der Staat, dem sie angehören oder in dem sich ihr Sitz oder ihre Niederlassung befindet, nach einer Bekanntmachung des Bundesministers der Justiz im Bundesgesetzblatt deutschen Staatsangehörigen und Personen mit Sitz oder Niederlassung im Geltungsbereich dieses Gesetzes einen entsprechenden Schutz gewährt.

§ 3

Anmeldung

(1) Eine Topographie, für die Schutz geltend gemacht wird, ist beim Patentamt schriftlich anzumelden. Für jede Topographie ist eine besondere Anmeldung erforderlich.

(2) Die Anmeldung muß enthalten:

1. einen Antrag auf Eintragung des Schutzes der Topographie, in dem diese kurz und genau bezeichnet ist;
2. Unterlagen zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topographie oder eine Kombination davon und Angaben über den Verwendungszweck, wenn eine Anordnung nach § 4 Abs. 4 in Verbindung mit § 9 des Gebrauchsmustergesetzes in Betracht kommt;
3. das Datum des Tages der ersten nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung der Topographie, wenn dieser Tag vor der Anmeldung liegt;
4. Angaben, aus denen sich die Schutzberechtigung nach § 2 Abs. 3 bis 6 ergibt.

(3) Der Bundesminister der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung über die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung Bestimmungen zu erlassen. Er kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf den Präsidenten des Patentamts übertragen.

(4) Sind die Erfordernisse für eine ordnungsgemäße Anmeldung nach Absatz 2 nicht erfüllt, so teilt das Patentamt dem Anmelder die Mängel mit und fordert ihn auf, diese innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung der Nachricht zu beheben. Wird der Mangel innerhalb der Frist behoben, so gilt der Zeitpunkt des Eingangs des Schriftsatzes beim Patentamt als Zeitpunkt der Anmeldung der Topographie. Das Patentamt stellt diesen Zeitpunkt fest und teilt ihn dem Anmelder mit.

(5) Mit der Anmeldung ist für jede angemeldete Topographie eine Gebühr nach dem Tarif zu entrichten. Unterbleibt die Zahlung, so gibt das Patentamt dem Anmelder Nachricht, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, wenn die Gebühr nicht bis zum Ablauf eines Monats nach Zustellung der Nachricht entrichtet wird. Wird die Anmeldegebühr innerhalb der Frist nicht gezahlt oder werden die in Absatz 4 genannten Mängel innerhalb der Frist nach Absatz 4 nicht behoben, so gilt die Anmeldung als nicht eingereicht; das Patentamt stellt dies fest und versagt die Eintragung.

§ 4

Eintragung, Bekanntmachung, Änderungen

(1) Entspricht die Anmeldung den Anforderungen des § 3, so verfügt das Patentamt die Eintragung in die Rolle für Topographien, ohne die Berechtigung des Anmelders zur Anmeldung, die Richtigkeit der in der Anmeldung angegebenen Tatsachen und die Eigenart der Topographie zu prüfen.

(2) Die Vorschriften des Gebrauchsmustergesetzes über die Eintragung in die Rolle, die Bekanntmachung im Patentblatt und Änderungen in der Rolle (§ 8 Abs. 1 bis 4) sind entsprechend anzuwenden.

(3) Die Vorschriften des Gebrauchsmustergesetzes über die Einsicht in die Rolle sowie in die Akten eingetragener Topographien einschließlich der Akten von Löschungsverfahren (§ 8 Abs. 5) sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß Einsicht in Unterlagen, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten und vom Anmelder als solche gekennzeichnet worden sind, nur in einem Löschungsverfahren vor dem Patentamt auf Anordnung der Topographieabteilung oder in einem Rechtsstreit über die Rechtsgültigkeit oder die Verletzung des Schutzes der Topographie auf Anordnung des Gerichts gegenüber den Personen gewährt wird, die an dem Löschungsverfahren oder an dem Rechtsstreit beteiligt sind. Unterlagen, die zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topographie erforderlich sind, können nicht in ihrer Gesamtheit als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse gekennzeichnet werden.

(4) Für Anträge in Angelegenheiten des Schutzes der Topographien (Topographieschutzsachen) mit Ausnahme der Löschungsanträge (§ 8) wird im Patentamt eine Topographiestelle gebildet, die von einem vom Präsidenten des Patentamts bestimmten rechtskundigen Mitglied geleitet wird. Über Löschungsanträge (§ 8) beschließt eine im Patentamt zu bildende Topographieabteilung, die mit zwei technischen Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied zu besetzen ist. Im übrigen sind die Vorschriften des Gebrauchsmustergesetzes über die Gebrauchsmusterstelle und die Gebrauchsmusterabteilungen (§ 10) und über die Geheimgebrauchsmuster (§ 9) entsprechend anzuwenden.

§ 5

Entstehung des Schutzes, Schutzdauer

(1) Der Schutz der Topographie entsteht

1. an dem Tag der ersten nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung der Topographie, es sei denn, daß die Topographie nicht innerhalb von zwei Jahren nach der ersten nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung beim Patentamt angemeldet wird, oder

2. an dem Tag, an dem die Topographie beim Patentamt angemeldet wird, falls der Schutz nicht schon nach Nummer 1 entstanden ist.

(2) Der Schutz der Topographie endet mit Ablauf des zehnten Kalenderjahres nach dem Jahr des Schutzbeginns.

(3) Der Schutz der Topographie kann nur geltend gemacht werden, wenn die Topographie beim Patentamt angemeldet worden ist.

(4) Der Schutz der Topographie kann nicht mehr in Anspruch genommen werden, wenn die Topographie nicht innerhalb von fünfzehn Jahren nach dem Tag der ersten Aufzeichnung nicht nur vertraulich geschäftlich verwertet oder beim Patentamt angemeldet wird.

§ 6

Wirkung des Schutzes

(1) Der Schutz der Topographie hat die Wirkung, daß allein der Inhaber des Schutzes befugt ist, sie zu verwerten. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung

1. die Topographie nachzubilden;

2. die Topographie oder das die Topographie enthaltende Halbleitererzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu verbreiten oder zu den genannten Zwecken einzuführen.

(2) Die Wirkung des Schutzes der Topographie erstreckt sich nicht auf

1. Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgeschäftlichen Zwecken vorgenommen werden;

2. die Nachbildung der Topographie zum Zwecke der Analyse, der Bewertung oder der Ausbildung;

3. die geschäftliche Verwertung einer Topographie, die das Ergebnis einer Analyse oder Bewertung nach Nummer 2 ist und Eigenart im Sinne von § 1 Abs. 2 aufweist.

(3) Wer ein Halbleitererzeugnis erwirbt, ohne zu wissen oder wissen zu müssen, daß es eine geschützte Topographie enthält, kann es ohne Zustimmung des Inhabers des Schutzes weiter verwerten. Sobald er weiß oder wissen muß, daß ein Schutz der Topographie besteht, kann der Inhaber des Schutzes für die weitere geschäftliche Verwertung des Halbleitererzeugnisses eine nach den Umständen angemessene Entschädigung verlangen.

§ 7

Beschränkung der Wirkung des Schutzes

(1) Der Schutz der Topographie wird nicht begründet, soweit gegen den als Inhaber Eingetragenen für jedermann ein Anspruch auf Löschung besteht (§ 8 Abs. 1 und 3).

(2) Wenn der wesentliche Inhalt der Anmeldung der Topographie eines anderen ohne dessen Einwilligung entnommen ist, tritt dem Verletzten gegenüber der Schutz des Gesetzes nicht ein. Die Vorschriften des Patentgesetzes über den Anspruch auf Übertragung (§ 8) sind entsprechend anzuwenden.

§ 8

Löschungsanspruch, Löschungsverfahren

(1) Jedermann hat gegen den als Inhaber Eingetragenen Anspruch auf Löschung des Schutzes der Topographie, wenn

1. die Topographie nach § 1 nicht schutzfähig ist,
2. der Anmelder oder der als Inhaber Eingetragene nicht nach § 2 Abs. 3 bis 6 zum Schutz berechtigt ist oder
3. die Topographie nicht innerhalb der Frist nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 oder nach Ablauf der Frist nach § 5 Abs. 4 angemeldet worden ist.

(2) Im Falle des § 7 Abs. 2 steht nur dem Verletzten ein Anspruch auf Löschung zu.

(3) Betreffen die Löschungsgründe nur einen Teil der Topographie, so wird sie nur in diesem Umfang gelöscht.

(4) Die Löschung des Schutzes der Topographie nach den Absätzen 1 bis 3 ist beim Patentamt schriftlich zu beantragen. Der Antrag muß die Tatsachen angeben, auf die er gestützt wird. Mit dem Antrag ist eine Gebühr nach dem Tarif zu zahlen; wird sie nicht gezahlt, so gilt der Antrag als nicht gestellt. Die Vorschriften des § 81 Abs. 7 und des § 125 des Patentgesetzes sind entsprechend anzuwenden.

(5) Die Vorschriften des Gebrauchsmustergesetzes über das Löschungsverfahren (§ 17), über die Rechtsmittel und Rechtsmittelverfahren (§ 18) und über die Wirkung des Löschungsverfahrens auf eine Streitsache (§ 19) sind entsprechend anzuwenden.

§ 9

Schutzverletzung

Wer den Vorschriften des § 6 Abs. 1 zuwider den Schutz der Topographie verletzt, kann vom Verletzten auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. Fällt dem Verletzer nur leichte Fahrlässigkeit zur Last, so kann das Gericht statt des Schadensersatzes eine Entschädigung festsetzen, die in den Grenzen zwischen dem Schaden des Verletzten und dem Vorteil bleibt, der dem Verletzer erwachsen ist. Die Vorschriften des § 24 Abs. 3 des Gebrauchsmustergesetzes sind entsprechend anzuwenden.

§ 10

Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 die Topographie nachbildet oder
2. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 die Topographie oder das die Topographie enthaltende Halbleitererzeugnis anbietet, in Verkehr bringt, vertreibt oder zu den genannten Zwecken einführt.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

(3) Wird auf Strafe erkannt, so ist, wenn der Verletzte es beantragt und ein berechtigtes Interesse daran dartut, anzuordnen, daß die Verurteilung auf Verlangen öffentlich bekanntgemacht wird. Die Art der Bekanntmachung ist im Urteil zu bestimmen.

§ 11

Anwendung von Vorschriften des Patentgesetzes und des Gebrauchsmustergesetzes

(1) Die Vorschriften des Patentgesetzes über die Erstattung von Gutachten (§ 29 Abs. 1 und 2), über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 123), über die Wahrheitspflicht im Verfahren (§ 124), über die Amtssprache (§ 126), über Zustellungen (§ 127) und über die Rechtshilfe der Gerichte (§ 128) sind auch für Topographieschutzsachen anzuwenden.

(2) Die Vorschriften des Gebrauchsmustergesetzes über die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe (§ 21 Abs. 2), über die Übertragung und die Lizenz (§ 22), über die Streitwertherabsetzung (§ 26), über die Gebrauchsmusterstreitsachen (§ 27), über die Inlandsvertretung (§ 28), über die Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen (§ 29) und über die Schutzberühmung (§ 30) sind entsprechend anzuwenden.

ZWEITER ABSCHNITT

Änderung der Gesetze auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes

§ 12

Änderung des Fünften Gesetzes zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes

In § 14 des Fünften Gesetzes zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 424-3-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 7 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2501), werden die Worte „und Gebrauchsmustersachen" durch die Worte „, Gebrauchsmuster- und Topographieschutzsachen" ersetzt.

§ 13

Änderung des Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts

Das Gesetz über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2188), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2501), wird wie folgt geändert:

1. In § 6 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 14 Abs. 2" durch die Angabe „§ 23 Abs. 2" ersetzt.

2. Der Zweite Unterabschnitt des Abschnitts „A. Gebühren des Patentamts" des Gebührenverzeichnisses (Anlage zu § 1) wird wie folgt gefaßt:

Nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Deutsche Mark
„120 000	II. Gebrauchsmustersachen	(unverändert)
121 000	1. Erteilungsverfahren	
121 100	a) Für die Anmeldung (§ 4 Abs. 4 des Gebrauchsmustergesetzes)	
121 200	b) Für den Antrag auf Ermittlung der in Betracht zu ziehenden Druckschriften (§ 7 Abs. 2)	
122 000	2. Aufrechterhaltung eines Gebrauchsmusters	
122 100	a) Verlängerungsgebühr	
122 101	für die erste Verlängerung der Schutzdauer (§ 23 Abs. 2)	(unverändert)
122 102	für die weitere Verlängerung der Schutzdauer (§ 23 Abs. 6)	
122 200	b) Zuschlag für die Verspätung der Zahlung einer Gebühr der Nummern 122 101 und 122 102 (§ 23 Abs. 2 Satz 4 und 6 und Abs. 6 Satz 2)	
123 000	3. Sonstige Anträge	
123 300	a) Für den Antrag auf Eintragung einer Änderung in der Person des Rechtsinhabers (§ 8 Abs. 4)	
123 600	b) Für den Antrag auf Löschung (§ 16)"	

3. Nach der Nummer 143 100 des Gebührenverzeichnisses (Anlage zu § 1) werden folgende Nummern eingefügt:

Nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Deutsche Mark
„150 000	V. Topographieschutzsachen	
151 000	1. Anmeldeverfahren	
151 100	Anmeldegebühr (§ 3 Abs. 5 des Halbleiterschutzgesetzes)	500
153 000	2. Sonstige Anträge	
153 300	a) Für den Antrag auf Eintragung einer Änderung in der Person des Rechtsinhabers (§ 4 Abs. 2 des Halbleiterschutzgesetzes in Verbindung mit § 8 Abs. 4 des Gebrauchsmustergesetzes)	60

Nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Deutsche Mark
153 600	b) Für den Antrag auf Löschung (§ 8 Abs. 4 des Halbleiterschutzgesetzes)	300"

4. Der Zweite Unterabschnitt des Abschnitts „B. Gebühren des Patentgerichts" des Gebührenverzeichnisses (Anlage zu § 1) wird wie folgt gefaßt:

Nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Deutsche Mark
„220 000	II. Gebrauchsmustersachen	(unverändert)
224 000	1. Beschwerdeverfahren	
224 100	Für die Einlegung der Beschwerde	
224 110	(i) gegen den Beschluß der Gebrauchsmusterstelle (§ 18 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes)	
224 120	(ii) gegen den Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung (§ 18 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes)	
225 000	2. Zwangslizenzverfahren	
225 100	a) Klagen	
225 110	(i) Für die Klage auf Erteilung einer Zwangslizenz (§ 20 des Gebrauchsmustergesetzes in Verbindung mit § 81 Abs. 6 des Patentgesetzes)	
225 120	(ii) Für die Einlegung der Berufung (§ 20 des Gebrauchsmustergesetzes in Verbindung mit § 110 Abs. 1 des Patentgesetzes)	(unverändert)
225 200	b) Einstweilige Verfügungen	
225 210	(i) Für den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung (§ 20 des Gebrauchsmustergesetzes in Verbindung mit § 85 Abs. 2 des Patentgesetzes)	
225 220	(ii) Für die Einlegung der Beschwerde gegen die Entscheidung über den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung (§ 20 des Gebrauchsmustergesetzes in Verbindung mit § 122 Abs. 2 des Patentgesetzes)"	

5. Der Vierte Unterabschnitt des Abschnitts „B. Gebühren des Patentgerichts" des Gebührenverzeichnisses (Anlage zu § 1) wird wie folgt gefaßt:

Nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Deutsche Mark
„240 000	IV. Musterregistersachen	(unverändert)
244 000	Beschwerdeverfahren	
244 100	Für die Einlegung der Beschwerde (§ 10 a des Geschmacksmustergesetzes)	
244 110	a) gegen die Entscheidung des Patentamts, die ein einzel-	

Nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Deutsche Mark
	nes Muster oder Modell betrifft	
244 120	b) gegen die Entscheidung des Patentamts, die eine Sammelanmeldung (§ 7 Abs. 9) betrifft"	(unverändert)

6. Nach der Nummer 244 120 des Gebührenverzeichnisses (Anlage zu § 1) werden folgende Nummern eingefügt:

Nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Deutsche Mark
„250 000	V. Topographieschutzsachen	
254 000	Beschwerdeverfahren	
254 100	Für die Einlegung der Beschwerde	
254 110	a) gegen den Beschluß der Topographiestelle (§ 8 Abs. 5 des Halbleiterschutzgesetzes in Verbindung mit § 18 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes)	200
254 120	b) gegen den Beschluß der Topographieabteilung (§ 8 Abs. 5 des Halbleiterschutzgesetzes in Verbindung mit § 18 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes)	350"

7. Nach der Nummer 254 120 des Gebührenverzeichnisses (Anlage zu § 1) werden folgende Nummern eingefügt:

Nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Deutsche Mark
„260 000	VI. Sortenschutzsachen	
264 000	Beschwerdeverfahren	
264 100	Für die Einlegung der Beschwerde gegen Beschlüsse der Widerspruchsausschüsse beim Bundessortenamt (§ 34 Abs. 2 des Sortenschutzgesetzes)	200"

§ 14

Änderung der Patentanwaltsordnung

Die Patentanwaltsordnung vom 7. September 1966 (BGBl. I S. 557), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 6 des Gesetzes vom 15. August 1986 (BGBl. I S. 1446), wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 2 Nr. 1 werden die Worte „Gebrauchsmusters oder" durch die Worte „Gebrauchsmusters, Schutzes einer Topographie oder" ersetzt.

2. In § 4 Abs. 1 werden nach den Worten „im Gebrauchsmustergesetz," die Worte „im Halbleiterschutzgesetz," eingefügt.

3. In § 43 Abs. 1 Nr. 1 werden die Worte „oder des § 12 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes" durch die Worte „, des § 21 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes oder des § 11 Abs. 2 des Halbleiterschutzgesetzes" ersetzt.

4. In § 155 Abs. 2 werden die Worte „§ 20 des Gebrauchsmustergesetzes" durch die Worte „§ 28 des Gebrauchsmustergesetzes, des § 11 Abs. 2 des Halbleiterschutzgesetzes" ersetzt.

5. In § 165 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „§ 20 des Gebrauchsmustergesetzes" durch die Worte „§ 28 des Gebrauchsmustergesetzes, des § 11 Abs. 2 des Halbleiterschutzgesetzes" ersetzt.

6. In § 178 Abs. 1 werden die Worte „§ 20 des Gebrauchsmustergesetzes" durch die Worte „§ 28 des Gebrauchsmustergesetzes, des § 11 Abs. 2 des Halbleiterschutzgesetzes" ersetzt.

7. Nach Absatz 2 wird folgender Absatz angefügt:

   „(3) Die Erteilung der erweiterten Vertretungsbefugnis erstreckt sich auf die Befugnis nach § 11 Abs. 2 des Halbleiterschutzgesetzes."

§ 15

Änderung des Gesetzes über die Beiordnung von Patentanwälten bei Prozeßkostenhilfe

Das Gesetz über die Beiordnung von Patentanwälten bei Prozeßkostenhilfe in der Fassung des § 187 der Patentanwaltsordnung vom 7. September 1966 (BGBl. I S. 557), zuletzt geändert durch § 43 Abs. 5 des Gesetzes vom 11. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2170), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 werden nach den Worten „im Gebrauchsmustergesetz," die Worte „im Halbleiterschutzgesetz," eingefügt.

2. In § 1 Abs. 2 werden nach den Worten „ein Gebrauchsmuster," die Worte „den Schutz einer Topographie," eingefügt.

§ 16

Änderung des Gesetzes über die Erstattung von Gebühren des beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchsmuster- und Sortenschutzsachen

Das Gesetz über die Erstattung von Gebühren des beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchsmuster- und Sortenschutzsachen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 424-5-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 7 des Gesetzes vom 15. August 1986 (BGBl. I S. 1446), wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift des Gesetzes und in § 1 wird nach dem Wort „Gebrauchsmuster-" das Wort ", Topographieschutz-" eingefügt.

2. In § 3 Abs. 2 Nr. 4 wird die Angabe „§ 10" durch die Angabe „§ 18" ersetzt.

3. Nach § 3 wird eingefügt:

„§ 3a

(1) In Topographieschutzsachen beträgt der Gebührensatz 450 Deutsche Mark.

(2) Dieser steht dem Vertreter als Verfahrensgebühr zu

1. im Eintragungsverfahren zu zehn Zehnteilen,
2. im Beschwerdeverfahren gegen Zurückweisung der Anmeldung zu dreizehn Zehnteilen,
3. im Löschungsverfahren zu fünfzehn Zehnteilen,
4. im Beschwerdeverfahren nach § 8 Abs. 5 des Halbleiterschutzgesetzes zu zwanzig Zehnteilen,
5. in anderen Beschwerdeverfahren zu drei Zehnteilen."

4. Der bisherige § 3a wird § 3b.

DRITTER ABSCHNITT

Änderung anderer Gesetze

§ 17

Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

§ 22 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 43-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juli 1986 (BGBl. I S. 1169), wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „der" vor der Angabe „§ 12" durch das Wort „des" ersetzt.

2. In Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 werden die Worte „§ 13 Abs. 1 bezeichneten Gewerbetreibenden und Verbände" durch die Worte „§ 13 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten Gewerbetreibenden, Verbände und Kammern" ersetzt.

§ 18

Änderung der Zugabeverordnung

In § 2 Abs. 1 Satz 2 der Zugabeverordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 43-4-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 1986 (BGBl. I S. 1169), wird die Angabe „§ 13 Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4" durch die Angabe „§ 13 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4" ersetzt.

§ 19

Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes

Das Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Januar 1987 (BGBl. I S. 475), wird wie folgt geändert:

1. § 120 Abs. 1 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt:

   „3. bei Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit (§§ 94 bis 100a des Strafgesetzbuches) sowie bei Straftaten nach § 52 Abs. 2 des Patentgesetzes, nach § 9 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes in Verbindung mit § 52 Abs. 2 des Patentgesetzes oder nach § 4 Abs. 4 des Halbleiterschutzgesetzes in Verbindung mit § 9 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes und § 52 Abs. 2 des Patentgesetzes,".

2. § 142a Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe d wird wie folgt gefaßt:

   „d) Straftaten nach § 52 Abs. 2 des Patentgesetzes, nach § 9 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes in Verbindung mit § 52 Abs. 2 des Patentgesetzes oder nach § 4 Abs. 4 des Halbleiterschutzgesetzes in Verbindung mit § 9 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes und § 52 Abs. 2 des Patentgesetzes;".

§ 20

Änderung des Rechtspflegergesetzes

§ 23 Abs. 1 des Rechtspflegergesetzes vom 5. November 1969 (BGBl. I S. 2065), zuletzt geändert durch § 13 des Gesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2563), wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 1 wird die Angabe „§ 11a" durch die Angabe „§ 20" ersetzt.

2. In Nummer 2 werden die Worte „§ 12 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes, § 44 Abs. 5 Satz 2 des Sortenschutzgesetzes" durch die Worte „§ 21 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes, § 11 des Halbleiterschutzgesetzes, § 36 des Sortenschutzgesetzes" ersetzt.

3. In Nummer 4 werden die Worte „§ 10 Abs. 2, § 11a des Gebrauchsmustergesetzes" durch die Worte „§ 18 Abs. 2, § 20 des Gebrauchsmustergesetzes, § 8 Abs. 5 des Halbleiterschutzgesetzes" ersetzt.

4. In den Nummern 5, 6, 8, 9, 10 und 12 werden die Worte „§ 10 Abs. 3 des Gebrauchsmustergesetzes" durch die Worte „§ 18 Abs. 3 des Gebrauchsmustergesetzes, § 8 Abs. 5 des Halbleiterschutzgesetzes" ersetzt.

5. In der Nummer 7 werden die Worte „§ 20 des Gebrauchsmustergesetzes" durch die Worte „§ 28 des Gebrauchsmustergesetzes, § 11 des Halbleiterschutzgesetzes" ersetzt.

6. Nummer 11 wird wie folgt gefaßt:

„11. die Entscheidung über Anträge auf Gewährung von Akteneinsicht an dritte Personen, sofern kein Beteiligter Einwendungen erhebt und es sich nicht um Akten von Patentanmeldungen, Patenten, Gebrauchsmusteranmeldungen, Gebrauchsmustern, angemeldeter oder eingetragener Topographien handelt, für die jede Bekanntmachung unterbleibt (§§ 50, 99 Abs. 3 des Patentgesetzes, §§ 9, 18 Abs. 3 des Gebrauchsmustergesetzes, § 4 Abs. 4, § 8 Abs. 5 des Halbleiterschutzgesetzes, § 13 Abs. 3 des Warenzeichengesetzes);".

§ 21

Änderung des Rechtsberatungsgesetzes

Artikel 1 § 3 Nr. 5 des Rechtsberatungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-12, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 6 des Gesetzes vom 18. August 1980 (BGBl. I S. 1503), wird wie folgt gefaßt:

„5. die Besorgung von Rechtsangelegenheiten auf dem Gebiet des Patent-, Gebrauchsmuster-, Topographieschutz- und Warenzeichenwesens in den in den §§ 177, 178 und 182 der Patentanwaltsordnung bestimmten Grenzen;".

§ 22

Änderung der Strafprozeßordnung

In § 374 Abs. 1 Nr. 8 der Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074) werden die Worte „§ 16 des Gebrauchsmustergesetzes" durch die Worte „§ 25 des Gebrauchsmustergesetzes, § 10 des Halbleiterschutzgesetzes" ersetzt.

§ 23

Änderung der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte

In § 66 Abs. 2 der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte in der im Bundesgesetzblatt Teil III Gliederungsnummer 368-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2496), werden die Worte „§ 10 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes" durch die Worte „§ 18 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes, § 8 Abs. 5 des Halbleiterschutzgesetzes in Verbindung mit § 18 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes" ersetzt.

§ 24

Änderung des Bewertungsgesetzes

In § 121 Abs. 2 Nr. 5 des Bewertungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Mai 1985 (BGBl. I S. 845), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 8 des Gesetzes vom 16. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2478), werden die Worte „und Gebrauchsmuster" durch die Worte „, Gebrauchsmuster und Topographien" ersetzt.

§ 25

Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen

In § 20 Abs. 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1980 (BGBl. I S. 1761), zuletzt geändert durch Artikel 5 Abs. 5 des Gesetzes vom 7. Juli 1986 (BGBl. I S. 977), wird nach dem Wort „Gebrauchsmustern" das Wort „, Topograhien" eingefügt.

VIERTER ABSCHNITT

Übergangs- und Schlußvorschriften

§ 26

Übergangsvorschriften

Der Schutz der Topographie kann nur für solche Topographien in Anspruch genommen werden, die nicht früher als zwei Jahre vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht nur vertraulich geschäftlich verwertet worden sind. Rechte aus diesem Gesetz können nur für die Zeit ab Inkrafttreten dieses Gesetzes geltend gemacht werden.

§ 27

Berlin-Klausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes, des Gebrauchsmustergesetzes und des Patentgesetzes erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes.

§ 28

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. November 1987 in Kraft.

Begründung

A. Allgemeines

I. Einleitung

Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 16. Dezember 1986 über den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen (87/54/EWG, ABl. Nr. L 24 vom 27. Januar 1987, S. 36—40). Rechtsgrundlage für die Richtlinie ist Artikel 100 Abs. 1 des Vertrags über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG-Vertrag), aufgrund dessen die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, diejenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften anzugleichen, die sich unmittelbar auf das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes auswirken.

Die Richtlinie ist den Mitgliedstaaten mit Schreiben des Ratspräsidenten vom 22. Dezember 1986, das der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Europäischen Gemeinschaften (EG) am 30. Dezember 1986 zuging, bekanntgemacht worden. Die Mitgliedstaaten sind nach Artikel 11 Abs. 1 der Richtlinie verpflichtet, die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften bis spätestens zum 7. November 1987 zu erlassen.

II. Inhalt und Anwendungsbereich der Richtlinie

1. Da Topographien von Halbleitererzeugnissen gegenwärtig nicht in allen Mitgliedstaaten der EG eindeutig durch bestehende Gesetze geschützt sind, da dieser Schutz — wo er besteht — unterschiedlich ausgestaltet ist und da dies nachteilige Auswirkungen auf das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes hat, schafft die Richtlinie einen rechtlichen Rahmen der Gemeinschaft für den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen. Dieser rechtliche Rahmen ist zunächst auf einige wichtige Grundsätze beschränkt. Es wird bestimmt, wer und was geschützt werden soll, welche ausschließlichen Rechte die geschützten Personen haben, um bestimmten Handlungen oder Ausnahmen von diesen Rechten zuzustimmen oder sie zu verbieten und welche Schutzdauer vorzusehen ist. Dagegen bleibt es den Mitgliedstaaten insbesondere freigestellt, ob sie den Schutz durch eine urheberrechtsähnliche Gesetzgebung ohne Registrierung oder ein gewerbliches Schutzrecht mit Registrierung sicherstellen. Weiterhin ist durch die Richtlinie nicht vorgegeben, ob und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen Zwangslizenzen erteilt werden können (s. hierzu unten Begründung zu § 8 unter Nummer 6).

2. Die Richtlinie sieht die Einführung eines Rechtsschutzes der Topographien von Halbleitererzeugnissen vor. Mikroelektronische Halbleitererzeugnisse, die sog. Mikro-Chips, bestehen aus „bedruckten" Halbleiterplättchen, insbesondere Siliziumplättchen, die integrierte elektrische Schaltungen (Integrated Circuits, I.C.) enthalten. Die auf häufig sehr aufwendigen Entwurfsprozessen beruhenden Schaltschemata werden in der Regel mit Hilfe eines Satzes von Schablonen, Masken genannt, in einem der Fotolithografie ähnlichen Verfahren schichtweise auf die Siliziumchips aufgebracht, so daß dreidimensionale Strukturen, Layouts oder Topographien genannt, entstehen, die nach vorher festgelegtem Muster umfangreiche Schaltungen auf kleinstem Raum verwirklichen. Statt über Masken können die Strukturen auch unmittelbar durch einen computergesteuerten Elektronenstrahl in entsprechend empfindliche Schichten eingeschrieben werden (Elektronenstrahllithografie). Beide Verfahren erfordern erheblichen Aufwand. Die Industrie, die Halbleitererzeugnisse entwickelt und produziert, ist ein Industriezweig mit außergewöhnlich zahlreichen und kostenträchtigen Innovationen; sie steht national und international in scharfem Wettbewerb.

III. Notwendigkeit des Rechtsschutzes

Der Entwurf eines einzigen Chips kann hohen Personaleinsatz erfordern, sehr zeitaufwendig sein und — insbesondere auch wegen des Einsatzes technischer Hilfsmittel — außerordentlich hohe Kosten verursachen. Werden Systeme von Chips hergestellt, kann deren Entwicklung Hunderte von Millionen DM und jahrelange Entwicklungsarbeit erfordern. Kopien der Topographien von Halbleitererzeugnissen können dagegen vergleichsweise leicht und in kurzer Zeit zu einem Bruchteil der Kosten hergestellt werden. Dabei wird in der Regel ein zur Herstellung identischer Chips geeigneter Maskensatz mit Fotografien der einzelnen Schichten des Originalchips, die nacheinander freigelegt werden, hergestellt. Werden diese Kopien vermarktet, können sie wesentlich billiger vertrieben werden als die mit den Entwicklungskosten belasteten Originalchips. Dadurch werden die Absatzmöglichkeiten der Originalhersteller beschränkt und ihre Chancen gemindert, ihre Innovations- und Investitionsleistung belohnt zu sehen. Den Originalherstellern entstehen so Verluste in Millionenhöhe.

IV. Schutzmöglichkeiten in der Bundesrepublik Deutschland

1. Zur Erhaltung von Innovationskraft und Investitionsbereitschaft der Halbleiterindustrie ist ein Schutz gegen das unrechtmäßige Kopieren von

Mikro-Chips erforderlich. Das geltende deutsche Rechtssystem gewährleistet, ebenso wie die Rechtssysteme fast aller Mitgliedstaaten der EG, diesen Kopierschutz nicht hinreichend.

2. Bei integrierten Schaltungen ist zwar grundsätzlich Patentschutz für Erfindungen im Bereich der Herstellungsverfahren, der Schaltungsfunktionen und auch der Halbleiterstruktur möglich. Die Entwicklung des Layouts und der im Maskensatz festgelegten Topographie der Chips überschreitet aber in der Regel nicht das Können eines Durchschnittsfachmanns. Sie wird in aller Regel nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und daher die Voraussetzungen für den Patentschutz nicht erfüllen. Dasselbe gilt für den Gebrauchsmusterschutz, der ebenfalls einen — wenn auch im Verhältnis zum Maß an erfinderischer Tätigkeit als Voraussetzung des Patentschutzes geringeren — erfinderischen Schritt voraussetzt. Im übrigen wird in vielen Fällen der für den Patent- und Gebrauchsmusterschutz notwendige Abstand von vorbekannten Chips, d. h. die erforderliche Neuheit, fehlen.

3. Unter bestimmten, engen Voraussetzungen können Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen sowie Darstellungen zur Herstellung solcher Topographien nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 des Urheberrechtsgesetzes urheberrechtlich geschützt sein. Voraussetzung für den Schutz im Einzelfall ist jedoch, daß es sich bei dem zu schützenden Gegenstand um eine persönliche geistige Schöpfung handelt (§ 2 Abs. 2 des Urheberrechtsgesetzes). Da insoweit eine gewisse Gestaltungshöhe, Originalität und Individualität gefordert werden, bleiben diejenigen Halbleitererzeugnisse, die diese Anforderungen nicht erfüllen, vom Urheberrechtsschutz ausgeschlossen.

   Im übrigen kann Urheberrechtsschutz zwar grundsätzlich für technische Zeichnungen und andere graphische Vorlagen, die im Laufe der Chip-Entwicklung entstehen, sowie für die die Herstellung von Masken oder Chips steuernden Computerprogramme bestehen. Es ist jedoch im Bereich der Topographien von Halbleitererzeugnissen nicht gesichert, daß das Urheberrecht — abgesehen von den Voraussetzungen, die hinsichtlich der Werkshöhe gegeben sein müssen — auch einen Schutz gegen die Verwertung graphischer Vorlagen zur Herstellung dreidimensionaler Gegenstände gewährt und daher gegen die Verwendung der graphischen Vorlagen bei der Herstellung von Masken oder Chips schützt. Das Urheberrecht allein kann daher einen wirksamen Schutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen nicht gewährleisten.

4. Der wettbewerbsrechtliche Schutz setzt zusätzlich zur bloßen Nachahmung besondere, die Sittenwidrigkeit begründende Umstände voraus. Liegen solche Umstände nicht vor und bleibt es bei der bloßen Nachahmung, sind nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen Ansprüche nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb nicht gegeben.

V. Sondergesetzliche Regelung in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Japan; Arbeiten der Weltorganisation für geistiges Eigentum

1. Als erstes Land haben die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) durch den „Semiconductor Chip Protection Act of 1984" vom 8. November 1984 einen urheberrechtsähnlichen Schutz des in Halbleiterchips enthaltenen Maskenwerks gegen seine unerlaubte Nachbildung und gegen die Verbreitung des eine solche Nachbildung enthaltenden Chips eingeführt (Title III of Public Law 98—620 of November 8, 1984, Chapter 9, Sec. §§ 901—914 — Protection of Semiconductor Chip Products —, of Title 17 — Copyrights — United States Code, 17 USC, 98 Stat. 3335ff., 3347 bis 3356; in deutscher Übersetzung abgedruckt im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, Bl. f. PMZ, 1985 S. 131ff.). Der Schutz wird für einen Zeitraum von zehn Jahren gewährt, der mit dem Zeitpunkt der Registrierung oder der ersten geschäftlichen Verwertung beginnt, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt (17 USC § 904 [a]).

   Ausländer können — abweichend vom Prinzip der Inländerbehandlung — den Schutz in den USA grundsätzlich nur erwerben, wenn ihr Heimatland Vertragspartner eines ein Maskenwerk schützenden Vertrages ist, dem die USA ebenfalls angehören, oder wenn das Maskenwerk erstmals in den USA geschäftlich verwertet worden ist (17 USC § 902 [a]). Darüber hinaus kann der Präsident der USA die Anwendbarkeit des Gesetzes auf Angehörige von anderen Staaten dann ausdehnen, wenn diese US-Staatsangehörigen einen im wesentlichen gleichen Schutz wie das US-Recht gewähren [Gegenseitigkeitsklausel, 17 USC § 902 (a) (2)]. Für eine Übergangsfrist von drei Jahren ab Inkrafttreten des Gesetzes ist der US-Handelsminister ermächtigt, den Schutz auf Ausländer auszudehnen, deren Heimatstaat echte Anstrengungen unternimmt und angemessene Fortschritte macht, die zum Abschluß eines Vertrages mit den USA oder zum Erlaß innerstaatlicher Rechtsvorschriften führen, die es dem Präsidenten der USA gestatten, später den Schutz auf unbestimmte Zeit zu verlängern (17 USC § 914).

   Auf Antrag der Kommission der EG ist den Angehörigen und Gebietsansässigen der EG-Mitgliedstaaten in den USA einstweiliger Schutz gewährt worden (17 USC § 914). Dieser Schutz, der nur bis zur Höchstdauer von drei Jahren nach Inkrafttreten des US-Gesetzes gewährt wird, läuft am 8. November 1987 ab. Ein weiterer Schutz ist nur unter den Voraussetzungen des 17 USC § 902 (a) (2) möglich.

2. Japan hat durch den „Act Concerning the Circuit Layout of a Semiconductor Integrated Circuit of 1985" einen ähnlichen Schutz eingeführt, die Gewährung eines Rechtsschutzes für ausländische Anmelder jedoch nicht von der Verbürgung der Gegenseitigkeit abhängig gemacht (Law No. 43, 1985, promulgated on May 31, 1985; in englischer Übersetzung abgedruckt in Industrial Property, Monthly Review of the World Intellectual Property

Organization, WIPO, Industrial Property Laws and Treaties, September 1985, Japan — Text 1—001, pages 001—011; in deutscher Übersetzung abgedruckt im Bl. f. PMZ 1986 S. 356ff.).

3. Auf internationaler Ebene hat die Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization, WIPO) in Genf Arbeiten an einem internationalen Vertrag über den Schutz von integrierten Schaltungen aufgenommen, durch den in jedem der künftigen Vertragsstaaten die Inländerbehandlung für die Staatsangehörigen und Unternehmen der anderen Vertragsstaaten sichergestellt werden soll. Die Bundesregierung beteiligt sich aktiv an diesen Arbeiten. Der Zeitpunkt für den Abschluß eines derartigen weltweiten Vertrages ist derzeit noch nicht abzusehen.

VI. Wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs

1. Der Gesetzentwurf dient der Ausführung der Richtlinie des Rates der EG vom 16. Dezember 1986 über den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen. Vorgesehen ist ein neues gewerbliches Schutzrecht sui generis, das Elemente des urheberrechtlichen Schutzes mit solchen gewerblicher Schutzrechte verbindet. Wie bei den übrigen gewerblichen Schutzrechten ist insbesondere eine zentrale Registrierung beim Deutschen Patentamt vorgesehen. Dies führt sowohl für die Rechtsinhaber als auch für Dritte zu größerer Rechtssicherheit und ermöglicht grundsätzlich jedermann Einsicht in die Unterlagen über die geschützten Topographien.

2. Im Ersten Abschnitt des Entwurfs ist der Schutz der Topographien im einzelnen geregelt. Schutzgegenstand ist die Topographie als solche, wenn und soweit sie Eigenart aufweist (§ 1). Der Schutz soll grundsätzlich demjenigen zustehen, der sie geschaffen hat oder sie im Rahmen eines Arbeits- oder Auftragsverhältnisses hat schaffen lassen (§ 2 Abs. 1 und 2). Dabei wird der Schutz auf Staatsangehörige von EG-Mitgliedstaaten und auf natürliche und juristische Personen mit Aufenthalt oder Niederlassung in EG-Mitgliedstaaten beschränkt sein (§ 2 Abs. 3); auf andere kann der Schutz erstreckt werden (§ 2 Abs. 6). Der Schutz soll nach dem Entwurf mit der erstmaligen geschäftlichen Verwertung der Topographie oder mit dem Antrag auf Eintragung beim Deutschen Patentamt entstehen, wobei der frühere der beiden Zeitpunkte maßgebend ist; geschäftliche Verwertungen, die vertraulichen Charakter haben, lassen den Schutz noch nicht entstehen; ist der Schutz mit der geschäftlichen Verwertung der Topographie entstanden, muß die Eintragung innerhalb von zwei Jahren nach Entstehung des Schutzes beim Deutschen Patentamt beantragt werden (§ 5 Abs. 1). Der Schutz soll nur geltend gemacht werden können, wenn die Topographie beim Deutschen Patentamt angemeldet worden ist (§ 5 Abs. 3). Vorgesehen ist eine Schutzdauer von zehn Kalenderjahren nach dem Jahr des Schutzbeginns (§ 5 Abs. 2). Außerdem soll der Schutz nur innerhalb von fünfzehn Jahren nach der ersten Aufzeichnung der Topographie in Anspruch genommen werden können (§ 5 Abs. 4).

   Das neue Schutzrecht soll — abweichend vom Patent- und Gebrauchsmusterrecht — ähnlich wie das Urheberrecht lediglich die Wirkung eines Nachbildungs- und Verwertungsverbots haben. Weder der bloße Besitz oder der Gebrauch der Topographie durch Dritte noch die Verwertung einer im Wege der Analyse einer geschützten Topographie hergestellten neuen Topographie (sogenanntes „reverse engineering") soll vom Schutzrecht erfaßt werden (§ 6). Im übrigen orientiert sich das Schutzrecht nach dem Entwurf eng am Gebrauchsmusterrecht. Soweit möglich, werden die Vorschriften des Gebrauchsmustergesetzes für entsprechend anwendbar erklärt oder die einschlägigen Vorschriften im wesentlichen übernommen.

   Die Schaffung des neuen Schutzrechts schließt den Schutz nach anderen Vorschriften, wie insbesondere den patent-, gebrauchsmuster-, urheber- oder wettbewerbsrechtlichen Schutz, nicht aus, soweit dessen Voraussetzungen gegeben sind.

3. Im Zweiten und Dritten Abschnitt des Entwurfs sind die notwendigen Änderungen in anderen Gesetzen vorgesehen. Dies gilt vor allem für die Vertretungsbefugnis der Patentanwälte und die Zuständigkeitsregelungen für die Rechtspfleger in Topographieschutzsachen sowie für die Gebührenvorschriften. Auch insoweit orientiert sich der Gesetzentwurf soweit wie möglich an den für Gebrauchsmuster geltenden Regelungen.

   Im übrigen werden die Verweisungen auf die Vorschriften des Gebrauchsmustergesetzes in anderen Gesetzen bereinigt, die durch die neue Paragraphenfolge der Neufassung des Gebrauchsmustergesetzes vom 28. August 1986 (BGBl. I S. 1455) unstimmig geworden sind.

VII. Kosten, Preise

Das beabsichtigte Gesetz wird sich nur sehr geringfügig auf den Bundeshaushalt auswirken.

Durch die Schutzgewährung sind zusätzliche Einnahmen beim Deutschen Patentamt zu erwarten. Bei den nach den Angaben der beteiligten Kreise und den Erfahrungen in den USA (dort sind in den ersten zwei Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes knapp 2 500 Anmeldungen beim Copyright Office eingegangen) in etwa zu erwartenden 500 Anmeldungen pro Jahr und einer sich an den entstehenden Kosten orientierenden Pauschalgebühr in Höhe von 500 DM werden sich Einnahmen in Höhe von 250 000 DM pro Jahr ergeben. Das Topographie-Eintragungsverfahren ist dem Gebrauchsmuster-Eintragungsverfahren vergleichbar. Der Kostenermittlung wurden daher die durchschnittlich im Gebrauchsmuster-Eintragungsverfahren anfallenden Kosten zugrunde gelegt. Es ist danach in Wahrung des Kostendeckungsprinzips eine einmalige Gebühr von 500 DM errechnet worden. Mehrausgaben werden bei der Festlegung einer Gebühr in dieser Höhe nicht entstehen.

Die weiteren Gebühreneinnahmen beim Deutschen Patentamt vor allem für Löschungsverfahren lassen sich derzeit nicht abschätzen, da nicht absehbar ist, in welchem Umfang Löschungen eingetragener Schutzrechte begehrt werden. Nach den Erfahrungen in den USA, wo in den ersten zwei Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes keine Streitfälle über den Schutz von Topographien bekanntgeworden sind, ist eher davon auszugehen, daß von der Möglichkeit der Löschung nur in äußerst geringem Umfang Gebrauch gemacht werden wird.

Die Übernahme der neuen Aufgaben nach dem Entwurf wird zu Mehrbelastungen für das Deutsche Patentamt führen. Bei den zu erwartenden etwa 500 Anmeldungen in- und ausländischer Anmelder pro Jahr wird das Deutsche Patentamt diese Mehrbelastung jedoch zunächst ohne zusätzliche Personalanforderung bewältigen können.

Sollten die Anmeldezahlen wider Erwarten in Zukunft erheblich steigen, wird zu prüfen sein, ob das ohne Folgen für die Personalausstattung bleiben kann. Da in diesem Falle auch die Gebühreneinnahmen entsprechend steigen werden, kann davon ausgegangen werden, daß es auch dann bei dem im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes geltenden Prinzip der Kostendeckung bleibt.

Das beabsichtigte Gesetz wird im übrigen keine Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben öffentlicher Haushalte haben.

Auswirkungen auf die Einzelpreise, insbesondere die Preise für Halbleitererzeugnisse und auf das allgemeine Preisniveau und dabei vorrangig das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. Die Kosten des Schutzrechts mit einer einmaligen Gebühr von 500 DM für die Anmeldung einer Topographie werden wegen der außergewöhnlich hohen Entwicklungskosten der Halbleitererzeugnisse nicht ins Gewicht fallen. Zu den Auswirkungen auf die Einzelpreise aufgrund der durch den Entwurf bezweckten Verdrängung billigerer nachgeahmter Produkte können keine Aussagen gemacht werden, da hierzu keine verwertbaren Zahlen vorliegen. Soweit billigere nachgeahmte Produkte durch das Gesetz vom Markt ferngehalten werden und dadurch das Preisniveau insoweit steigt, ist das eine notwendige Folge des mit dem Gesetz angestrebten Zwecks der Unterbindung von Produktpiraterie.

B. Zu den einzelnen Vorschriften

(Auf die entsprechenden Artikel der Richtlinie wird in Klammern hingewiesen)

I. Zum Ersten Abschnitt (Schutz der Topographien)

Zu § 1 (Schutzgegenstand, Eigenart; Artikel 1 Abs. 1 Buchstaben a und b, Artikel 2 Abs. 2 und Artikel 8 der Richtlinie)

1. Absatz 1 Satz 1 bezeichnet als Schutzgegenstand des neu geschaffenen gewerblichen Schutzrechts die Topographien von Halbleitererzeugnissen und definiert sie als die dreidimensionalen Strukturen solcher mikroelektronischer Halbleitererzeugnisse. Diese Definition entspricht der Richtlinie (Artikel 1 Abs. 1 Buchstabe b), ohne deren sehr ins einzelne gehenden Definitionselemente und die Definition des Halbleitererzeugnisses zu übernehmen, da sie für die Klarheit des Gesetzes entbehrlich erscheinen.

   a) Demnach ist mit dem „Halbleitererzeugnis" die endgültige Form oder Zwischenform eines Erzeugnisses gemeint, das aus einem Materialteil besteht, der eine Schicht aus halbleitendem Material enthält und mit einer oder mehreren Schichten aus leitendem, isolierendem oder halbleitendem Material versehen ist, die nach einem vorab festgelegten dreidimensionalen Muster angeordnet sind, und das ausschließlich oder neben anderen Funktionen eine elektronische Funktion übernehmen soll (Artikel 1 Abs. 1 Buchstabe a der Richtlinie). Diese Definition des Halbleitererzeugnisses entspricht dem heutigen Stand der technischen Entwicklung.

      Für den Fall, daß sich der Stand der Technik in einer Weise weiterentwickelt, die heute noch nicht bestimmbar ist, ist in die Richtlinie eine Vorschrift aufgenommen worden, nach der diese Definition des Halbleitererzeugnisses auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit des Rates der EG zur Anpassung an die technische Entwicklung geändert werden kann (Artikel 1 Abs. 2). Diese Änderungsmöglichkeit ist in den Entwurf nicht übernommen worden, weil die weite Fassung der Definition ohnehin Anpassungen an die weitere Entwicklung ermöglicht.

   b) Mit der dreidimensionalen Struktur von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen, d. h. der „Topographie", ist eine Reihe in Verbindung stehender Bilder gemeint, die ein festgelegtes dreidimensionales Muster der Schichten darstellen, aus denen ein Halbleitererzeugnis besteht, und so miteinander in Verbindung stehen, daß jedes Bild das Muster einer Oberfläche des Halbleitererzeugnisses aufweist (Artikel 1 Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie).

2. Voraussetzung der Schutzfähigkeit der Topographie ist, daß sie „Eigenart" aufweist. In den Entwurf ist damit ein Begriff aufgenommen worden, der, um den sui-generis-Charakter des neuen Schutzrechts hervorzuheben, gegenüber vergleichbaren Begriffen in anderen Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums neu ist. Näher definiert wird dieser Begriff in Absatz 2.

3. a) Durch Satz 2 von Absatz 1 werden „selbständig verwertbare Teile" von Topographien in den Schutz einbezogen. In der Richtlinie wird dies dadurch klargestellt, daß die Bilder auch so miteinander in Verbindung stehen können, daß jedes Bild nur einen Teil des Musters einer Oberfläche des Halbleitererzeugnisses aufweist (Artikel 1 Abs. 1 Buchstabe b [ii]). Damit wird sichergestellt, daß auch schon die aufwendige

Entwicklung von Teilen von Topographien, wie sogenannten Zellen und „gate-arrays", die zur Verwendung in unterschiedlichen Halbleitererzeugnissen geeignet sind und im geschäftlichen Verkehr als für die Ausarbeitung von Gesamttopographien verwendbare Elemente angeboten werden, durch ein Schutzrecht abgesichert werden kann.

b) Weiterhin wird nach Satz 2 von Absatz 1 der Schutz auf den Satz der „Darstellungen" erstreckt, mit dessen Hilfe solche Topographien hergestellt werden. In der Richtlinie wird der Schutz insoweit ausgedehnt auf eine Topographie bestehend aus einer Reihe von Bildern, unabhängig von der Art ihrer Fixierung oder Kodierung, die so miteinander in Verbindung stehen, daß jedes Bild das Muster einer Oberfläche des Halbleitererzeugnisses in einem beliebigen Fertigungsstadium aufweist (Artikel 1 Abs. 1 Buchstabe b). Somit sind nicht nur die Aufzeichnungen in Masken und Herstellungsbändern vom Schutz erfaßt, sondern auch jede andere Art der Aufzeichnung. Dies wird in der Richtlinie auch dadurch bestimmt, daß nicht nur die endgültige Form, sondern jede Zwischenform eines Halbleitererzeugnisses vom Schutz erfaßt werden soll (Artikel 1 Abs. 1 Buchstabe a).

4. In Absatz 2 wird der Begriff „Eigenart" definiert. Der Begriff Eigenart deckt sich weder mit dem der Eigentümlichkeit nach § 1 Abs. 2 des Geschmacksmustergesetzes noch mit dem der persönlich geistigen Schöpfung nach § 2 Abs. 2 des Urheberrechtsgesetzes noch mit dem des erfinderischen Schrittes nach § 1 Abs. 1 des Gebrauchsmustergesetzes noch mit dem der erfinderischen Tätigkeit nach § 4 des Patentgesetzes.

   Die Richtlinie hat auf einen selbständigen Begriff für die Schutzvoraussetzung verzichtet und sie in Anlehnung an das amerikanische Recht lediglich umschrieben. Das US-Recht schließt den Schutz für ein Maskenwerk aus, das nicht „original" ist (17 USC § 902 [b] [1]) oder aus Konstruktionen besteht, die in der Halbleiterindustrie „staple", „commonplace" oder „familiar" sind (17 USC § 902 [b] [2]).

   Nach Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie soll die Topographie unter der Voraussetzung geschützt werden, daß sie das Ergebnis der eigenen geistigen Arbeit ihres Schöpfers und in der Halbleiterindustrie nicht alltäglich ist. Diese Definition ist inhaltlich in den Entwurf übernommen worden. Um den bewußten und gewollten Abstand zu den sonstigen Schutzvoraussetzungen der Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums deutlich zu machen, ist aber der selbständige Begriff der Eigenart gewählt worden.

   Entsprechend der Richtlinie sollen nach dem Entwurf die in der Halbleiterindustrie alltäglichen oder durch bloße Nachbildung, d. h. ohne geistige Arbeit, geschaffenen Topographien, die folglich keine Entwicklungsarbeit erfordern und keine besonderen Investitionskosten verursachen, vom Schutz ausgenommen werden.

   a) Der Entwurf orientiert sich an den Definitionen der Richtlinie. Die Topographie darf folglich nicht in der Halbleiterindustrie „alltäglich" sein („commonplace"). Der in diesem Industriebereich allgemein übliche Standard soll vom Schutz ausgeschlossen werden. Damit muß aber nicht etwa das Erfordernis der patentrechtlichen oder gebrauchsmusterrechtlichen Neuheit erfüllt sein (§ 3 des Patentgesetzes, § 3 Abs. 1 des Gebrauchsmustergesetzes). Da der Schutz sich nur gegen das unbefugte Nachbilden richten, die unabhängige Schöpfung einer bereits existierenden Topographie und vor allem die Herstellung eines Halbleitererzeugnisses auf der Grundlage der Analyse einer geschützten Topographie aber nicht ausschließen soll, („reverse engineering", § 6 Abs. 2 Nr. 3), erschiene ein absolutes Neuheitserfordernis nicht sachgerecht.

   b) Die Topographie darf nicht durch „bloße Nachbildung" einer anderen Topographie hergestellt worden sein, d. h. sie muß das „Ergebnis einer geistigen Arbeit" sein. Die reine Nachbildung einer fremden Topographie ist damit nicht schutzfähig. Unberührt davon bleibt die Schutzfähigkeit einer Topographie, die im Wege der Analyse einer fremden Topographie nachgeschaffen worden ist („reverse engineering"). Mit der durch Absatz 2 vom Schutz ausgeschlossenen Topographie ist eine Topographie gemeint, die von einer anderen schlicht „abgekupfert" worden ist. Damit muß die schutzfähige Topographie aber noch keine persönlichen oder das Können eines Durchschnittsfachmanns überschreitenden Merkmale aufweisen. Die Schutzfähigkeit nach Absatz 2 verlangt nicht etwa eine persönliche geistige Schöpfung im Sinne von § 2 Abs. 2 des Urheberrechtsgesetzes. Die von der Rechtsprechung zu dem hinreichenden schöpferischen Eigentümlichkeitsgrad, der sogenannten schöpferischen Gestaltungshöhe im Sinne von § 2 Abs. 2 des Urheberrechtsgesetzes, entwickelten Grundsätze können auf den Begriff der Eigenart und den Begriff der geistigen Arbeit nicht übertragen werden.

5. In Absatz 3 wird entsprechend Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 der Richtlinie bestimmt, daß eine „Anordnung" an sich nicht schutzfähiger Teile schutzfähig ist, wenn die Anordnung als solche Eigenart aufweist. Die Ausdehnung des Schutzes auf solche Anordnungen alltäglicher Teile erscheint angemessen, da viele Neuentwicklungen gerade durch Anordnungen bekannter Elemente die Funktionen von Halbleitererzeugnissen vermehren oder verbessern. Dies ist, soweit Eigenart besteht, gleichfalls schutzwürdig.

6. Absatz 4 stellt ebenso wie Artikel 8 der Richtlinie klar, daß nur die Topographie der Halbleitererzeugnisse als solche geschützt ist, nicht aber die in ihnen verkörperten gedanklichen Inhalte.

Zu § 2 (Recht auf den Schutz; Artikel 3 der Richtlinie)

1. Absatz 1 entspricht der bei Rechten zum Schutz des geistigen Eigentums üblichen Regel, daß das Schutzrecht grundsätzlich dem Schöpfer oder Erfinder der geschützten Leistung zusteht (Artikel 3 Abs. 1 der Richtlinie).

2. In Absatz 2 wird entsprechend der in der Richtlinie vorgesehenen Gestaltungsmöglichkeit (Artikel 3 Abs. 2) bestimmt, daß das Schutzrecht grundsätzlich dem Arbeitgeber oder Auftraggeber zusteht, wenn die Herstellung der Topographie im Rahmen eines Arbeits- oder Auftragsverhältnisses geschieht. Andere ausdrückliche oder stillschweigende Abreden können bewirken, daß das Schutzrecht dem Arbeitnehmer oder Beauftragten verbleibt. Eine derartige Regelung kann auch Bestandteil eines Tarifvertrages sein.

   Da der durch den Entwurf zu schaffende Rechtsschutz seine Rechtfertigung in den außerordentlich zeit- und kostenaufwendigen Investitionen der Entwicklung von Topographien und der Herstellung von Mikro-Chips findet, erscheint es sachgerecht, den Rechtsschutz grundsätzlich demjenigen zuzusprechen, der diese hohen Forschungs- und Entwicklungskosten aufwendet. Da es in der Regel nicht um den Schutz einer Erfindung oder einer persönlich geistigen Schöpfung geht, erscheint es gerechtfertigt, die Rechte des Erfinders oder Schöpfers dem Recht auf Investitionsschutz des Auftraggebers oder Arbeitgebers grundsätzlich nachzuordnen. Sollte die Entwicklung der Topographie jedoch zugleich eine Erfindung darstellen oder Werkhöhe im Sinne des Urheberrechts erreichen, so bleibt es insoweit bei den geltenden Regelungen des Patent- und Gebrauchsmusterrechts einschließlich des Arbeitnehmererfinderrechts sowie des Urheberrechts.

3. Durch Absatz 3 wird in Übernahme von Artikel 3 Abs. 3 der Richtlinie der Schutz auf Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EG und auf natürliche und juristische Personen beschränkt, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder eine Niederlassung in dem Gebiet haben, in dem der EWG-Vertrag gilt. In der Richtlinie wird zudem noch ausdrücklich klargestellt, daß nur tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche Niederlassungen oder Handelsniederlassungen einen nach dieser Richtlinie zu schaffenden Schutz begründen können [Artikel 3 Abs. 3 Buchstabe b (ii)]. Eine Übernahme dieser Klarstellung in den Entwurf erschien entbehrlich, weil nach deutscher Rechtsordnung Scheinniederlassungen keine Niederlassungen im Rechtssinne sind.

   Den juristischen Personen werden im zweiten Halbsatz von Absatz 3 klarstellend die von der Richtlinie erfaßten, aber nicht ausdrücklich genannten Gesellschaften gleichgestellt, die Träger von Rechten und Pflichten sein können, ohne juristische Personen zu sein.

   Mit der Beschränkung des Schutzes auf die Staats- oder Gebietsangehörigen der Mitgliedstaaten der EG folgen Richtlinie und Entwurf der Systematik des US-Rechts (17 USC § 902 [a]). Grundsätzlich sollen nur die im Bereich der EG erbrachten Leistungen geschützt und soll der Schutz nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit nur auf die Staaten ausgedehnt werden, die ihrerseits den Unternehmen aus dem Bereich der EG einen entsprechenden Investitionsschutz gewähren. Dieses System könnte abgelöst werden von einem System der Inländerbehandlung im Rahmen eines internationalen Vertrages. Die Bundesregierung unterstützt die entsprechenden Bemühungen im Rahmen der WIPO.

4. In Absatz 4 wird entsprechend dem Grundansatz von Absatz 3, vorrangig die im Bereich der EG getätigten Investitionen zu schützen, der Schutz auch auf die Topographien erstreckt, die ein Berechtigter nach Absatz 3 erstmals im Bereich der EG geschäftlich verwertet, selbst wenn er sie vorher von einem selbst nicht Schutzberechtigten erworben hat (Artikel 3 Abs. 4 der Richtlinie).

   Diese Erweiterung der Schutzberechtigung ist darin begründet, daß ein Unternehmen bei dem Erwerb einer von einem Dritten entwickelten Topographie in der Regel die von diesem erbrachten Entwicklungskosten übernehmen wird. Es ist deshalb sachgerecht, ihn beim Zugang zum Investitionsschutz so zu behandeln, als ob er diese Kosten von Anfang an selber aufgebracht hätte. Ohne Schutzgewährung wäre ein derartiger Erwerb zur alleinigen Verwertung wirtschaftlich nicht sinnvoll.

   Um Umgehungen des grundsätzlich nur für Entwicklungen aus dem Bereich der EG zu gewährenden Investitionsschutzes zu verhindern, muß der Berechtigte nach Absatz 4 die alleinige Befugnis haben, die Topographie in dem Gebiet zu verwerten, in dem der EWG-Vertrag gilt. Anderenfalls würden gegebenenfalls mehrere den Rechtsschutz für dieselbe Topographie in Anspruch nehmen können, solange diese noch nicht alltäglich ist. Die Topographie darf vorher noch nicht an einem anderen Ort geschäftlich verwertet worden sein, da bei einer vorherigen Verwertung außerhalb des Gebietes, in dem der EWG-Vertrag gilt, nicht mehr davon auszugehen ist, daß der Erwerber aus dem Bereich der EG die Investitionskosten des ursprünglichen Herstellers tatsächlich in vollem Umfang übernimmt. Im übrigen würde ohne diese Einschränkung eine Umgehung der Beschränkung des Schutzes auf Unternehmen aus dem Bereich der EG nicht mehr aufzuhalten sein. Vorherige lediglich vertrauliche Verwertungen schließen den Schutz nicht aus.

5. Mit Absatz 5 wird der Rechtsschutz auf die jeweiligen Rechtsnachfolger der Berechtigten erstreckt. Diese Regelung folgt Artikel 3 Abs. 5 der Richtlinie. Es erscheint notwendig und auch sachgerecht, den Schutz auf den jeweiligen Rechtsnachfolger zu erstrecken, da anderenfalls das Recht auf den Schutz im Falle der Rechtsnachfolge ersatzlos wegfiele. Diese Regelung entspricht im übrigen dem generellen System des gewerblichen Rechtsschut-

zes, wonach der Rechtsnachfolger des Erfinders dem Erfinder insoweit rechtlich gleichgestellt wird (vgl. z. B. § 6 Satz 1 des Patentgesetzes).

Der Rechtsnachfolger eines Berechtigten nach den Absätzen 1 bis 4 muß dabei nicht etwa seinerseits die Voraussetzungen des Absatzes 3 erfüllen. Der Rechtsnachfolger kann auch ein Unternehmen mit Sitz außerhalb der EG sein. Anderenfalls würde der Wert der Entwicklungen von Unternehmen aus dem Bereich der EG bei dem Bemühen um Veräußerung an Unternehmen außerhalb des Bereichs der EG nachhaltig gemindert.

Mit Rechtsnachfolge ist nicht nur die rechtsgeschäftliche Rechtsnachfolge gemeint, sondern z. B. auch der Erbgang. Im Falle des Rechtsüberganges durch Erbfolge geht die Schutzberechtigung auf den Erben unabhängig davon über, ob er Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der EG ist. Anderenfalls würde gegebenenfalls das Recht auf den Schutz durch den Erbfall ersatzlos wegfallen.

6. Nach Absatz 6 kann in Umsetzung der Vorschriften des Artikels 3 Abs. 6 und 7 der Richtlinie der Schutz auch auf andere als die in Absatz 3 beschriebenen Personen durch völkerrechtliche Vereinbarung, Recht der EG oder Bekanntmachung des Bundesministers der Justiz erstreckt werden. Hierbei ist vorrangig das angestrebte völkerrechtliche Übereinkommen im Rahmen der WIPO gemeint, nach dem den Angehörigen der Vertragsstaaten Inländerbehandlung eingeräumt werden soll. Aber auch bilaterale Verträge werden voraussichtlich abzuschließen sein. In erster Linie wird hier an bilaterale Vereinbarungen mit den Staaten zu denken sein, die bereits einen entsprechenden Schutz gesetzlich eingeführt haben, wie bisher die USA und Japan. Aber auch mit anderen Staaten, die nicht der EG angehören und in denen die deutsche Halbleiterindustrie schon jetzt ihre Erzeugnisse im größeren Umfang verwertet, werden voraussichtlich bilaterale Verträge abzuschließen sein, um den Angehörigen dieser Staaten denselben Zugang zum deutschen Markt zu ermöglichen, wie den Angehörigen der Mitgliedstaaten der EG und den Unternehmen mit Sitz oder Niederlassung in dem Gebiet, in dem der EWG-Vertrag gilt.

   Auf Japan wird der Schutz schon durch Bekanntmachung des Bundesministers der Justiz erstreckt werden können, da deutsche Anmelder in Japan schon jetzt den freien Zugang zum Schutzrecht haben. Nach japanischem Recht ist der Schutz nicht von der Verbürgung der Gegenseitigkeit abhängig gemacht worden.

   Die Mitgliedstaaten der EG sind auf Grund der Richtlinie nicht mehr vollkommen frei, den Schutz durch einseitige Erklärung oder im Wege bilateraler und multilateraler Vereinbarungen ohne Einschaltung der EG zu erstrecken (Artikel 3 Abs. 6 und 7 der Richtlinie). Der Rat der EG kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission den Rechtsschutz auf die Angehörigen von Drittstaaten mit Wirkung für den gesamten Bereich der EG ausdehnen. Der Mitgliedstaat hat deswegen seine Absicht zur Aufnahme von bilateralen Vereinbarungen der Kommission mitzuteilen. Beabsichtigt der Mitgliedstaat, den Schutz auf Angehörige von Drittstaaten durch einseitige Erklärung oder im Wege bilateraler Vereinbarung zu erstrekken, so teilt er diese Absicht der Kommission mit und setzt seine Entscheidung über die Ausdehnung des Schutzes für eine begrenzte Zeit von einem Monat aus. Die Kommission hat innerhalb dieser Frist die Möglichkeit, die Erstreckung des Schutzes auf den Drittstaat für den gesamten Bereich der EG einzuleiten. Das Verfahren ist im einzelnen in Artikel 3 Abs. 6 und 7 der Richtlinie geregelt.

Zu § 3 (Anmeldung; Artikel 4 Abs. 1, 2, 4 und 5 der Richtlinie)

1. § 3 orientiert sich an der Vorschrift des § 4 des Gebrauchsmustergesetzes. Ebenso wie beim Gebrauchsmuster und aus den im allgemeinen Teil dieser Begründung genannten Erwägungen der größeren Rechtssicherheit schreibt der Entwurf eine Registrierung vor. Die Eintragung hat jedoch eine vom Gebrauchsmusterrecht abweichende rechtliche Wirkung. Die Anmeldung beim Deutschen Patentamt ist lediglich Voraussetzung für die Geltendmachung des Schutzrechts (siehe § 5 Abs. 3 des Entwurfs).

2. In Absatz 1 Satz 1 wird entsprechend § 4 Abs. 1 Satz 1 des Gebrauchsmustergesetzes bestimmt, daß die Einleitung des Eintragungsverfahrens einen schriftlichen Antrag erfordert. Ebenso wie im Patentrecht (§ 35 Abs. 1 Satz 2 des Patentgesetzes) und im Gebrauchsmusterrecht (§ 4 Abs. 1 Satz 2 des Gebrauchsmustergesetzes) wird in Satz 2 von Absatz 1 für jeden Gegenstand der Anmeldung, d. h. für jede Topographie, eine gesonderte Anmeldung gefordert (Einheitlichkeit des Schutzgegenstandes).

3. In Absatz 2 werden die einzelnen Anmeldeerfordernisse bestimmt. Diese Vorschrift folgt dem Vorbild des § 4 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes, enthält jedoch auch inhaltliche Abweichungen.

   a) Die Regelung in Nummer 1 entspricht § 4 Abs. 2 Nr. 1 des Gebrauchsmustergesetzes. Die Kurzbezeichnung wird der Name oder in der Regel die Produktbezeichnung sein, unter der die Topographie oder das die Topographie enthaltende Halbleitererzeugnis im Handel ist oder in den Handel gebracht werden soll. Die anzugebende Kurzbezeichnung muß hinreichende Unterscheidungsmerkmale gegenüber anderen im Handel befindlichen Topographien oder Halbleitererzeugnissen aufweisen. Eine reine Sammelbezeichnung für einen bestimmten Typ einer Topographie oder eines Halbleitererzeugnisses wird nicht genügen.

   b) Die Bestimmung in Nummer 2 übernimmt nicht die Regelung des § 4 Abs. 2 Nr. 3 des Gebrauchsmustergesetzes, nach der die Anmeldung eine Beschreibung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters enthalten muß, da eine Topographie sich nicht mit Worten in einer Beschreibung darstellen läßt. Nach dem derzei-

tigen Erkenntnisstand ist eine schriftliche Darstellung nicht geeignet, den Schutzgegenstand einer Topographie in identifizierbarer Form zu offenbaren. Dagegen können zum Beispiel die Masken oder das Layout zu ihrer Herstellung oder der Chip selbst die Topographie in eindeutiger Weise veranschaulichen. Der Entwurf sieht daher statt einer Beschreibung die Vorlage von Unterlagen vor, die die Topographie identifizieren oder veranschaulichen oder eine Kombination von beidem enthalten. In der Richtlinie ist die Vorlage derartiger Unterlagen ausdrücklich vorgesehen (Artikel 4 Abs. 1 Satz 2).

Die vorzulegenden Unterlagen werden häufig aus dem Satz der Masken oder Maskenteile bestehen, mit deren Hilfe das Halbleitererzeugnis hergestellt wird. Dabei müssen aber im Gegensatz zu dem, was bei einer Beschreibung im üblichen Sinne notwendig wäre, nicht alle Masken vorgelegt werden. Es genügt die Vorlage derjenigen Masken oder Maskenteile, die die Topographie hinreichend identifizieren oder veranschaulichen. Ist für eine Veranschaulichung oder Identifizierung der Topographie nicht die Vorlage aller Masken erforderlich, muß der Antragsteller folglich auch nicht alle Masken vorlegen. Dies trägt seinem angesichts der einfachen Kopiermöglichkeiten gesteigerten Schutzbedürfnis Rechnung. Welche Unterlagen der Antragsteller zur Identifizierung oder Veranschaulichung seiner Topographie für ausreichend und notwendig hält, obliegt im Eintragungsverfahren seiner Entscheidung. Wird aus den von ihm vorgelegten Unterlagen der von ihm beanspruchte Schutzgegenstand allerdings nicht hinreichend veranschaulicht, so geht dies in einem Löschungs- oder Verletzungsverfahren gegebenenfalls zu seinen Lasten, da er insoweit dann den Schutzanspruch nicht dartun kann. Es wird damit im Interesse des Anmelders liegen, jedenfalls die Unterlagen dem Deutschen Patentamt einzureichen, die für den Erfolg in einem eventuellen Löschungs- oder Verletzungsverfahren entscheidend sind.

Die Unterlagen müssen die Topographie auch nicht in der Art offenbaren, daß diese von jedem Durchschnittsfachmann nachentwickelt werden kann. Da der Schutz der Topographie nach dem Entwurf nicht als absoluter Schutz ausgestaltet ist, nach dem jeder Dritte gehindert wäre, ohne Zustimmung des Berechtigten die Topographie zu besitzen, zu benutzen oder auf Grund eigener geistiger Arbeit nachzuentwickeln und diese Nachentwicklung dann zu verwerten, ist es gerechtfertigt, an die Offenbarung auch nicht dieselben Anforderungen zu stellen wie an die Offenbarung im Patent- und Gebrauchsmusterrecht.

Zusätzlich ist der Verwendungszweck von dem Anmelder anzugeben, wenn er davon ausgehen muß, daß eine Anordnung über die Geheimstellung der Topographie gemäß § 9 des Gebrauchsmustergesetzes in Betracht kommt (§ 4 Abs. 4 Satz 3 des Entwurfs). Um beurteilen zu können, ob ein Staatsgeheimnis im Sinne des § 93 des Strafgesetzbuches vorliegt, ist es notwendig, dem Anmelder in dieser Hinsicht besondere Mitteilungspflichten aufzuerlegen, da anders als der Beschreibung im Patent- und Gebrauchsmusterrecht den Unterlagen zur Identifizierung oder Veranschaulichung einer Topographie nicht notwendig zu entnehmen ist, daß es sich um ein Staatsgeheimnis handelt.

c) Nach Nummer 3 hat der Anmelder das Datum des Tages der ersten nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung der Topographie dem Deutschen Patentamt mitzuteilen, wenn diese vor dem Tag der Anmeldung lag, weil der Schutz in diesen Fällen bereits mit dieser ersten geschäftlichen Verwertung entstanden ist (§ 5 Abs. 1 des Entwurfs). Diese Angabe ist sowohl für das Deutsche Patentamt als auch für jeden Dritten zur Berechnung der Schutzdauer von Bedeutung. Mit der Formulierung der nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung ist die geschäftliche Verwertung ausgeschlossen, die unter der Abrede der Vertraulichkeit zwischen den Vertragspartnern erfolgt, solange diese Abrede eingehalten wird.

d) Nummer 4 sieht die Angabe der Umstände vor, aus denen sich die Schutzberechtigung nach § 2 Abs. 3 bis 6 des Entwurfs ergibt. Diese Angabe wird sich bei Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in dem Gebiet, in dem der EWG-Vertrag gilt, bereits aus der Anschrift ergeben. Hat der Anmelder jedoch weder einen Wohnsitz noch eine Niederlassung in diesem Gebiet, wird er nähere Angaben darüber zu machen haben, woraus sich seine Berechtigung zum Schutz nach den Absätzen 3 bis 6 von § 2 des Entwurfs ergibt.

4. Entsprechend der Regelung im Gebrauchsmusterrecht werden nach Absatz 3 die näheren Einzelheiten der Erfordernisse der Anmeldung in der Anmeldeverordnung bestimmt werden (vgl. § 4 Abs. 3 des Gebrauchsmustergesetzes).

5. Absatz 4 regelt das Verfahren bei formellen Mängeln der Anmeldung in Anlehnung an § 10 Abs. 3 des Geschmacksmustergesetzes in der am 1. Juli 1988 in Kraft tretenden Fassung (BGBl. 1986 I S. 2501). Ebenso wie nach dem Geschmacksmustergesetz soll der Akt der Anmeldung seine rechtsgestaltende Wirkung oder seine Wirkung als Voraussetzung für die Geltendmachung des Schutzrechts (§ 5 Abs. 1 des Entwurfs) nur und auch erst dann erhalten, wenn er mängelfrei vorgenommen wird oder bei Vorliegen von Mängeln diese beseitigt werden (vgl. im übrigen die Begründung zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Geschmacksmustergesetzes, BT-Drucksache 10/5346, S. 21).

6. Die Regelung in Absatz 5 hinsichtlich der Zahlung der Anmeldegebühr folgt der des Gebrauchsmusterrechts; wird die Gebühr nicht mit der Anmeldung und nicht innerhalb einer vom Deutschen Patentamt zu setzenden Frist gezahlt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (vgl. § 4 Abs. 4 des Gebrauchsmustergesetzes). In Anlehnung an

§ 10 Abs. 4 des Geschmacksmustergesetzes in der am 1. Juli 1988 in Kraft tretenden Fassung soll das Deutsche Patentamt bei nicht fristgerechter Zahlung der Anmeldegebühr oder bei nicht fristgerechter Mängelbeseitigung feststellen, daß die Anmeldung als nicht eingereicht gilt und die Eintragung versagen.

Wegen der Höhe der Gebühr wird auf die Erläuterung zu § 13 des Entwurfs verwiesen. Die mit der Anmeldung zu zahlende Gebühr ist eine Pauschalgebühr für die gesamte Schutzdauer von zehn Jahren. Die Möglichkeit von Verlängerungen einer zunächst auf drei Jahre begrenzten Schutzdauer wie im Gebrauchsmustergesetz (§ 23) ist nach diesem Entwurf nicht vorgesehen. Die Richtlinie verlangt einen zehnjährigen Schutz (Artikel 7 Abs. 3) und folgt insoweit dem US-Gesetz (17 USC § 904 [b]). Es erscheint weder erforderlich noch angebracht, diesen zehnjährigen Schutz wie im Patent- und Gebrauchsmusterrecht zu staffeln, weil der Schutz einer Topographie den freien Wettbewerb in keiner Weise behindern kann. Der Schutz einer Topographie schließt die Entstehung von Schutzrechten an einer dieser Topographie nachentwikkelten zweiten Topographie nicht aus, wenn die zweite Topographie Eigenart hat.

Zu § 4 (Eintragung, Bekanntmachung, Änderungen; Artikel 4 Abs. 1 bis 3 der Richtlinie)

1. Absatz 1 lehnt sich an § 8 Abs. 1 des Gebrauchsmustergesetzes an. Ebenso wie im Gebrauchsmustergesetz bestimmt der Entwurf, daß die Eintragung ohne Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen erfolgt. Auch eine eingehende Prüfung des Einheitlichkeitserfordernisses ist nicht vorgesehen. Es handelt sich um ein reines Registrierungsverfahren; das durch den Entwurf vorgesehene Schutzrecht ist wie das Gebrauchsmusterrecht ein ungeprüftes Schutzrecht, das anders als das Gebrauchsmuster sogar schon vor der Eintragung entstehen kann.

   Der Eintragung geht nur eine Formalprüfung voraus. Das Deutsche Patentamt muß feststellen, ob die Anmeldung einen Antrag auf Eintragung des Schutzes, dieser Antrag eine Kurzbezeichnung enthält und ihm Unterlagen zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topographie oder eine Kombination davon beigefügt sind, ob gegebenenfalls das Datum des Tages der ersten nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung der Topographie angegeben ist und Angaben zur Schutzberechtigung des Anmelders gemacht worden sind. Hinsichtlich der die Topographie veranschaulichenden Unterlagen hat das Deutsche Patentamt lediglich festzustellen, ob dem Antrag Unterlagen beigefügt sind. Ob diese Unterlagen die Topographie ausreichend veranschaulichen, wird erst in einem Löschungs- oder Verletzungsverfahren zu prüfen sein, in dem es auf den Schutzgegenstand ankommt.

   Anders als in § 8 Abs. 1 des Gebrauchsmustergesetzes wird in Absatz 1 § 49 Abs. 2 des Patentgesetzes nicht für entsprechend anwendbar erklärt. Nach dieser Vorschrift kann die Verfügung über die Eintragung auf Antrag des Anmelders bis zu fünfzehn Monaten ausgesetzt werden. Die Möglichkeit der Aussetzung der Eintragungsverfügung und damit auch der Veröffentlichung der Eintragung im Patentblatt und in der Rolle hat den Sinn, den Anmelder vor nachteiligen Folgen der Veröffentlichung der Eintragung für noch durchzuführende Auslandsanmeldungen zu bewahren. Dem Anmelder kann bei der Auslandsanmeldung gegebenenfalls das eigene deutsche Schutzrecht als neuheitsschädlich entgegengehalten werden. Da der Schutz der Topographie jedoch keine Neuheit voraussetzt, kann eine deutsche Voreintragung einer späteren Auslandsanmeldung auch nicht neuheitsschädlich entgegenstehen. Für die entsprechende Anwendbarkeit der Regelung des § 49 Abs. 2 des Patentgesetzes besteht daher kein Bedarf.

2. Nach Absatz 2 werden die Vorschriften über die Gebrauchsmusterrolle (§ 8 Abs. 1 bis 4 des Gebrauchsmustergesetzes) für entsprechend anwendbar erklärt. Insoweit kann in vollem Umfang auf die zu dieser Vorschrift entwickelten Rechtsgrundsätze verwiesen werden.

3. In Absatz 3 wird die Einsicht in die Rolle sowie in die Akten eingetragener Topographien einschließlich der Akten von Löschungsverfahren in Anlehnung an § 8 Abs. 5 des Gebrauchsmustergesetzes geregelt, jedoch in Umsetzung von Artikel 4 Abs. 2 der Richtlinie mit einer wesentlichen Einschränkung. Der Anmelder soll die Möglichkeit haben, diejenigen Teile der Unterlagen, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten, als solche zu bezeichnen und insoweit die Einsicht in die Unterlagen auf Löschungs- und Verletzungsverfahren und damit auf die Personen zu beschränken, die an dem Löschungsverfahren oder an dem Rechtsstreit beteiligt sind. Diese Einschränkung findet ihre Rechtfertigung in der durch die vergleichsweise einfachen Kopiermöglichkeiten begründeten besonderen Schutzbedürftigkeit des Anmelders, der ein Interesse daran haben kann, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die den Unterlagen zu entnehmen sein mögen, verborgen zu halten. Unterlagen, die für die Veranschaulichung der Topographie im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 des Entwurfs erforderlich sind, dürfen allerdings nicht in ihrer Gesamtheit als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse bezeichnet werden (Satz 2 von Absatz 3), weil sonst die Identifizierung der geschützten Topographie ausgeschlossen wäre.

   Von den betroffenen Wirtschaftskreisen ist darüber hinaus die rechtliche Möglichkeit gefordert worden, generell zumindest Teile der Unterlagen über noch nicht verwertete Topographien bei der Hinterlegung durch Schwärzungen oder andersartige Ausblendungen unkenntlich zu machen, da die detaillierte Topographie der Leitungsebenen eines mit hohem Aufwand an Investitionen entwickelten mikroelektronischen Halbleiterchips in der Regel ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis darstelle. Diese Möglichkeit biete auch das US- und das japa-

nische Recht. Des weiteren ist auch verlangt worden, im Rahmen der Akteneinsicht die Herstellung von Fotokopien grundsätzlich für unzulässig zu erklären, da anderenfalls das Deutsche Patentamt zur „Kopierbörse" werde.

Diese sehr weitgehenden Forderungen unterliegen dem Zielkonflikt zwischen der im gewerblichen Rechtsschutz eingeführten freien Akteneinsicht und dem mit dem Entwurf sicherzustellenden Kopierschutz. Dieser Konflikt soll nach dem Entwurf dahin gehend gelöst werden, daß der Anmelder zwar die Teile seiner Unterlagen, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten, Dritten gegenüber nur in einem Löschungs- oder Verletzungsverfahren offenbaren muß, wobei sich die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse auch auf Teile von Unterlagen beziehen können, die zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topographie erforderlich sind. Die darüber hinausgehende generelle Schwärzung von Teilen der Unterlagen und das Verbot der Herstellung von Fotokopien würden es aber in der Regel der im Deutschen Patentamt Einsicht nehmenden Person unmöglich machen, allein durch bloße Augenscheinseinnahme dieser zum Teil geschwärzten Unterlagen die mit der Akteneinsicht üblicherweise ermöglichte Vergewisserung über die spezifische Beschaffenheit des geschützten Gegenstandes zu erlangen. Ohne die Überlassung von Kopien der Unterlagen zur Ermöglichung der näheren Überprüfung mit sonstigen Hilfsmitteln wäre dem Sinne der Akteneinsicht nicht entsprochen. Dem auch bei den übrigen gewerblichen Schutzrechten mit der zentralen Registrierung beim Deutschen Patentamt verfolgten Zweck der Rechtssicherheit sowohl für den Rechtsinhaber als auch für Dritte könnte nicht mehr entsprochen werden.

4. Nach Absatz 4 soll in Anlehnung an § 10 des Gebrauchsmustergesetzes für das Anmelde- und Eintragungsverfahren eine Topographiestelle entsprechend der Gebrauchsmusterstelle und für das Löschungsverfahren eine Topographieabteilung entsprechend den Gebrauchsmusterabteilungen beim Deutschen Patentamt gebildet werden. Die Zusammensetzung der Topographiestelle und der Topographieabteilung entspricht der der Gebrauchsmusterstelle und der Gebrauchsmusterabteilung, da insoweit vergleichbare Arbeiten beim Deutschen Patentamt anfallen werden. Die Einrichtung einer Topographiestelle und einer Topographieabteilung schafft unabhängig von den Notwendigkeiten der Einstellung weiteren Personals die aus Organisationsgründen erwünschte Möglichkeit, neben der Gebrauchsmusterstelle und den Gebrauchsmusterabteilungen eigenständige Organisationseinheiten im Deutschen Patentamt zu bilden. Dadurch wird der Präsident des Deutschen Patentamts in die Lage versetzt, den für diesen speziellen technischen Bereich geeigneten Beschäftigten des Deutschen Patentamts die Aufgaben in Topographieschutzangelegenheiten gegebenenfalls zusätzlich übertragen zu können.

   Satz 3 von Absatz 4 enthält die verfahrensmäßigen Verweisungen auf die Bestimmungen des § 10 des Gebrauchsmustergesetzes hinsichtlich Gebrauchsmusterstelle und Gebrauchsmusterabteilungen. Des weiteren wird die Vorschrift über das Geheimgebrauchsmuster (§ 9 des Gebrauchsmustergesetzes) für entsprechend anwendbar erklärt, da Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen durchaus ein Staatsgeheimnis im Sinne des § 93 des Strafgesetzbuches zum Gegenstand haben können. Die Vorschriften des Gebrauchsmustergesetzes und insoweit auch des Patentgesetzes über Geheimgebrauchsmuster und -patente finden in vollem Umfang Anwendung.

Zu § 5 (Entstehung des Schutzes, Schutzdauer; Artikel 4 Abs. 1, Artikel 7 Abs. 1, 3 und 4 der Richtlinie)

1. In Absatz 1 wird entsprechend Artikel 7 Abs. 1 Buchstabe a der Richtlinie bestimmt, daß das Schutzrecht am Tag der ersten nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung der Topographie oder an dem Tag der Anmeldung der Topographie beim Patentamt entsteht, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt. Diese Bestimmung übernimmt die Regelung des US-Rechts (17 USC § 904 [a]). Damit ist in dem Entwurf eine gegenüber dem Urheberrecht und den traditionellen gewerblichen Schutzrechten ungewöhnliche Entstehung des Schutzrechts vorgesehen. Das Schutzrecht entsteht weder mit der Schöpfung noch mit der Eintragung, sondern knüpft an hiervon abgehobene alternative Realakte an. Diese „Systemwidrigkeit" ist durch die Richtlinie vorgegeben, die sich insoweit an dem US-Recht orientiert. Im US-Recht und in der Richtlinie sind für die Schutzrechtsentstehung Zeitpunkte gewählt worden, die zwischen den im Urheberrecht und den im gewerblichen Rechtsschutz maßgeblichen Zeitpunkten liegen. Dies ist auch als Kompromiß in den die Verhandlungen über die Richtlinie prägenden Auseinandersetzungen über den urheberrechtlichen oder den Ansatz des gewerblichen Rechtsschutzes zu sehen. Um bei der Entstehung des Schutzrechts mit der ersten geschäftlichen Verwertung einen Zeitpunkt festlegen zu können, der auch von Dritten feststellbar ist, läßt eine geschäftliche Verwertung, bei der die Vertragsparteien Vertraulichkeit vereinbart haben, das Schutzrecht noch nicht entstehen.

   Entsteht das Schutzrecht mit der ersten geschäftlichen Verwertung der Topographie, so muß es nach Nummer 1 innerhalb von zwei Jahren nach der ersten geschäftlichen Verwertung beim Deutschen Patentamt ordnungsgemäß angemeldet werden. Dabei muß die Anmeldung die formellen Erfordernisse des § 3 Abs. 2 des Entwurfs erfüllen (§ 3 Abs. 4 des Entwurfs). Anderenfalls gilt das Schutzrecht als nicht entstanden. Diese Regelung folgt der Vorschrift des Artikels 4 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinie, die ihrerseits das US-Recht übernimmt (17 USC § 908 [a]). Hiermit soll sichergestellt werden, daß das durch die Verwertung entstandene Schutzrecht nicht allzulange bestehen bleibt, ohne daß Dritte das Bestehen dieses Schutzrechts in Erfahrung bringen können.

Die Registrierung hat damit vorrangig den Zweck, Dritte über bestehende Schutzrechte zu informieren. Es erscheint darüber hinaus interessengerecht, den Berechtigten innerhalb einer begrenzten Frist von zwei Jahren zur Anmeldung der Topographie zu verpflichten, wenn er das Schutzrecht über diese Zeit hinaus in Anspruch nehmen will.

2. Nach Absatz 2 wird in Übernahme von Artikel 7 Abs. 3 der Richtlinie die Schutzdauer auf zehn Jahre festgelegt. Die zehnjährige Schutzdauer entspricht dem US-Gesetz (17 USC § 904 [b]). Entsprechend dem US-Gesetz (17 USC § 904 [c]) und der Richtlinie endet die Schutzdauer immer an dem letzten Tag eines Kalenderjahres. Die Schutzdauer ist dadurch für alle Beteiligten leichter zu berechnen. Da die zehnjährige Schutzdauer sich von dem letzten Tag des Kalenderjahres an berechnet, in dem das Schutzrecht entstanden ist, kann die effektive Dauer des Schutzes sich auf fast elf Jahre verlängern.

3. Durch Absatz 3 wird bestimmt, daß das Schutzrecht erst dann geltend gemacht werden kann, wenn es beim Patentamt angemeldet worden ist. Diese Regelung lehnt sich an das US-Gesetz an, das jedoch grundsätzlich die Erteilung der Eintragungsbestätigung für die Geltendmachung voraussetzt (17 USC § 910). Die Geltendmachung des Schutzrechts von der Eintragung abhängig zu machen, erscheint jedoch zu weitgehend, da das Schutzrecht bereits vorher durch die geschäftliche Verwertung oder die Anmeldung entstanden ist und der Anmelder auf die Eintragung keinen Einfluß hat. Es erscheint angemessener, die Geltendmachung des Schutzrechts von dem Zeitpunkt der Anmeldung beim Deutschen Patentamt abhängig zu machen, den der Berechtigte bestimmen kann. Diesen Zeitpunkt abzuwarten, ist dem Berechtigten aus Gründen der Rechtssicherheit allerdings auch dann zuzumuten, wenn das Schutzrecht schon vor der Anmeldung durch geschäftliche Verwertung entstanden ist.

4. In Absatz 4 wird in Übernahme von Artikel 7 Abs. 4 der Richtlinie bestimmt, daß ein Schutzrecht nicht mehr entstehen kann, wenn es innerhalb von fünfzehn Jahren nach der ersten Aufzeichnung der Topographie weder nicht nur vertraulich geschäftlich verwertet noch beim Deutschen Patentamt angemeldet wird. Der Berechtigte wird dadurch gezwungen, innerhalb von fünfzehn Jahren nach Fertigstellung der Topographie oder gegebenenfalls auch eines selbständig verwertbaren Teils der Topographie die zehnjährige Schutzdauer in Lauf zu setzen. Diese der Herbeiführung von Gewißheit über die mögliche Existenz von Schutzrechten dienende Regelung erscheint für den Berechtigten zumutbar. Da lediglich alltägliche Topographien vom Schutz ausgeschlossen sind und die zu schützende Topographie keine Neuheit im Sinne des Patent- und Gebrauchsmusterrechts aufweisen muß, ist es angebracht, eine absolute Grenze von fünfzehn Jahren für die Möglichkeit der Entstehung des Schutzes aufzustellen.

Zu § 6 (Wirkung des Schutzes; Artikel 1 Abs. 1 Buchstabe c, Artikel 5 der Richtlinie)

1. Nach Absatz 1 wird in Übernahme von Artikel 5 Abs. 1 der Richtlinie die Wirkung des Topographieschutzrechts auf einen Schutz gegen das Nachbilden beschränkt. Dies reicht aus, um die Wettbewerbsverzerrung zwischen Originalhersteller und Hersteller schlichter Kopien zu beseitigen. Ein weitergehender absoluter Schutz erscheint nur für solche Topographien gerechtfertigt und erforderlich, die nach dem Patent- oder Gebrauchsmustergesetz geschützt werden, d. h. wenn und soweit sie Erfindungshöhe und Neuheit aufweisen.

   Im übrigen gibt das Schutzrecht entsprechend der Legaldefinition der geschäftlichen Verwertung in der Richtlinie (Artikel 1 Abs. 1 Buchstabe c) dem Berechtigten nur das Recht, jedem Dritten zu verbieten, das die Topographie enthaltende Halbleitererzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu verbreiten oder zu den genannten Zwecken einzuführen. Anders als im Patent- und Gebrauchsmusterrecht (vgl. § 9 Satz 2 Nr. 1 des Patentgesetzes und § 11 Abs. 1 Satz 2 des Gebrauchsmustergesetzes) ist der berechtigte Erwerb, Besitz, Gebrauch und die berechtigte Nutzung der geschützten Topographie nicht von der Zustimmung des Schutzrechtsinhabers abhängig. Jeder Dritte darf die geschützte Topographie selbst zu geschäftlichen Zwecken ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers erwerben, besitzen, gebrauchen und auch zu eigenen Zwecken geschäftlich nutzen. Er darf die geschützte Topographie nur nicht ohne Zustimmung des Berechtigten verwerten. Mit Verwertung ist der Verkauf, die Vermietung, das Leasing und jede Form des Vertriebs und der Verbreitung und ein Angebot zu diesen Zwecken gemeint. Auch diese Einschränkung des Schutzrechts folgt dem US-Recht (17 USC § 905).

2. Nach Absatz 2 wird die Wirkung des Schutzrechts in Übernahme des Artikels 5 Abs. 2 bis 4 der Richtlinie eingeschränkt.

   a) Nach Nummer 1 werden Handlungen Dritter zu privaten Zwecken von der Wirkung des Schutzrechts ausgenommen (vgl. auch Artikel 5 Abs. 2 der Richtlinie). Diese Ausnahme entspricht der üblichen Einschränkung der gewerblichen Schutzrechte (§ 11 Nr. 1 des Patentgesetzes, § 12 Nr. 1 des Gebrauchsmustergesetzes). In Abweichung von diesen Vorschriften wird entsprechend der Richtlinie die geschäftliche und nicht nur die gewerbliche Verwertung untersagt. Damit ist die weitestgehende Formulierung gewählt worden, da eine Verwertung geschäftlich sein kann, ohne gewerblich zu sein; denn die gewerbliche Verwertung erfolgt zumindest bei Gelegenheit einer Berufsausübung, während bei einer geschäftlichen Verwertung die reine Gewinnerzielungsabsicht ohne Berufsausübung genügt. In der Praxis werden die Unterschiede gering sein. Der Entwurf folgt hier jedoch wörtlich der Richtlinie.

b) In Nummer 2 wird entsprechend Artikel 5 Abs. 3 der Richtlinie die Nachbildung der Topographie zum Zwecke der Analyse, Bewertung oder Ausbildung von der Schutzwirkung ausgenommen. Auch diese Einschränkung des Schutzrechts orientiert sich an den traditionellen gewerblichen Schutzrechten (§ 11 Nr. 2 des Patentgesetzes, § 12 Nr. 2 des Gebrauchsmustergesetzes). Darüber hinausgehend sind jedoch sämtliche Versuchs- und Forschungshandlungen von der Schutzwirkung nach dem Entwurf ausgenommen. Es ist nicht nur erlaubt, eine geschützte Topographie zu Versuchszwekken zu analysieren und dafür nachzubilden. Die Nachbildung darf auch der Bewertung oder der Ausbildung dienen. Begrenzt wird diese Ausnahme nur durch das generelle Verbot der geschäftlichen Verwertung. Eine nachgebildete Topographie darf nicht etwa an Forschungsinstitute von Dritten gewinnbringend veräußert werden. Die geschäftliche Nutzung der Topographie bleibt allein dem Berechtigten vorbehalten.

c) In Nummer 3 wird das sogenannte „reverse engineering" geregelt. Diese Vorschrift setzt Artikel 5 Abs. 4 der Richtlinie um, der seinerseits dem US-Gesetz folgt (17 USC § 906 [a] [2]). Danach schließt das Schutzrecht nicht das Recht Dritter aus, eine geschützte Topographie zu analysieren und das Ergebnis dieser Analyse in eine eigene Topographie zu übernehmen. Verboten ist demnach lediglich die reine Nachbildung. Entwickelt ein Dritter eine geschützte Topographie zurück und benutzt er die dabei gefundenen Erkenntnisse, um eine eigene Topographie zu schaffen (sogenanntes „reverse engineering"), so ist ihm dies erlaubt. Die auf diesem Wege entwickelte Topographie muß aber ihrerseits Eigenart aufweisen, d. h. sie darf nicht lediglich der Ursprungstopographie nachgebildet, d. h. nicht schlicht „abgekupfert" sein. Die Rückentwicklung der geschützten Topographie und die Neuentwicklung der zweiten Topographie muß das Ergebnis einer eigenen geistigen Arbeit sein. Bei einer identischen oder quasi identischen Nachschöpfung wird der Beweis des ersten Anscheins dafür sprechen, daß die Topographie schlicht nachgebildet worden ist. Der Dritte wird dann im Streitfalle dartun und beweisen müssen, daß er die identische Topographie tatsächlich selbständig geschaffen hat und sich nur der erlaubten Analyse und der Verwertung dieses Analyseergebnisses bedient hat.

3. Absatz 3 setzt Artikel 5 Abs. 6 der Richtlinie um, indem der gutgläubige Erwerb eines Halbleitererzeugnisses, das eine geschützte Topographie enthält, von der Schutzwirkung des Verwertungsverbots nach Absatz 1 Nr. 2 ausgenommen wird. Der Erwerber hat dem Berechtigten eine Entschädigung nur für die geschäftliche Verwertung zu entrichten, die er vornimmt, nachdem er von dem Schutzrecht Kenntnis erlangt oder fahrlässigerweise nicht erlangt hat. Gegen Nachbildung ist die Topographie auch gegenüber dem gutgläubigen Erwerber geschützt.

   Dieser Schutz gutgläubiger Dritter erscheint gerechtfertigt, weil das Schutzrecht anders als traditionelle gewerbliche Schutzrechte nicht recherchierbar ist. Das bereits mit der ersten geschäftlichen Verwertung entstandene Schutzrecht wird für einen Dritten häufig nicht als solches erkennbar sein. Feststellbar wird für einen Dritten ein Schutzrecht in der Regel erst mit der Bekanntmachung der Eintragung im Patentblatt unter der angegebenen Kurzbezeichnung sein. Dabei wird es von den jeweiligen Umständen des konkreten Einzelfalles abhängen, ob ein Dritter zumindest hätte wissen müssen, daß ein Schutzrecht besteht. Er wird dann nicht mehr gutgläubig Halbleitererzeugnisse erwerben können, die eine geschützte Topographie enthalten. Die vorher gutgläubig erworbenen Halbleitererzeugnisse kann er dann nur noch gegen eine angemessene Entschädigung verwerten. Dabei wird davon auszugehen sein, daß die übliche Lizenzgebühr eine angemessene Entschädigung darstellt.

Zu § 7 (Beschränkung der Wirkung des Schutzes; Artikel 4 Abs. 6 der Richtlinie)

1. In Absatz 1 wird wie in § 13 Abs. 1 des Gebrauchsmustergesetzes bestimmt, daß die Schutzwirkung nicht eintritt, wenn ein Anspruch auf Löschung besteht. Nach § 8 Abs. 1 des Entwurfs besteht ein Löschungsanspruch u. a., wenn die Topographie nicht schutzfähig ist. Insoweit lehnt sich der Entwurf eng an das Gebrauchsmustergesetz an.

2. Absatz 2 regelt in Umsetzung des Artikels 4 Abs. 6 der Richtlinie den Fall der widerrechtlichen Entnahme in Anlehnung an die Vorschrift des § 13 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes. Ebenso wie im Gebrauchsmusterrecht handelt es sich hierbei um ein relatives Schutzhindernis. Das Schutzrecht ist nur dem Verletzten gegenüber unwirksam. Damit steht auch nur diesem ein Anspruch auf Löschung gegen den als Inhaber Eingetragenen zu (§ 8 Abs. 2 des Entwurfs).

   Im übrigen ist die Vorschrift des Patentgesetzes (§ 8) über den Anspruch des Berechtigten auf Übertragung gegen den zu Unrecht als Inhaber Eingetragenen für entsprechend anwendbar zu erklären, um dem sachlich Berechtigten die volle Rechtsstellung des Rechtsinhabers einzuräumen.

Zu § 8 (Löschungsanspruch, Löschungsverfahren)

1. In Absatz 1 werden in Anlehnung an § 15 Abs. 1 des Gebrauchsmustergesetzes die Löschungsgründe bestimmt. Löschungsgrund nach Nummer 1 ist die fehlende Schutzfähigkeit nach § 1 des Entwurfs, d. h. die fehlende Eigenart der Topographie. Löschungsgrund nach Nummer 2 ist die fehlende Schutzberechtigung nach § 2 Abs. 3 bis 6 des Entwurfs, d. h. ein fehlender Bezug des Berechtig-

ten zur EG oder zu einem Staat, auf dessen Angehörige der Schutz erstreckt worden ist. Die fehlende Schutzberechtigung nach § 2 Abs. 1 und 2 des Entwurfs ist kein Löschungsgrund nach Absatz 1, sondern nach Absatz 2. Wird das Recht von jemandem angemeldet, der dazu nach § 2 Abs. 1 oder 2 des Entwurfs nicht berechtigt ist, so liegt ein Fall der widerrechtlichen Entnahme vor, der nur dem Verletzten einen Löschungsanspruch gibt (§ 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 des Entwurfs).

Nach Nummer 3 ist für den Fall ein Löschungsanspruch gegeben, daß die Topographie eingetragen wurde, obwohl sie länger als zwei Jahre vor der Anmeldung nicht nur vertraulich geschäftlich verwertet worden ist (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 des Entwurfs) oder länger als fünfzehn Jahre vor der ersten nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung oder der Anmeldung aufgezeichnet, d. h. fertiggestellt worden ist (§ 5 Abs. 4 des Entwurfs).

2. In Absatz 2 wird entsprechend § 15 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes für den Fall der widerrechtlichen Entnahme dem Verletzten und nur diesem ein Löschungsanspruch zuerkannt.

3. In Absatz 3 wird in Anlehnung an § 15 Abs. 3 des Gebrauchsmustergesetzes die Möglichkeit der Teillöschung geregelt. Die Möglichkeit der Beschränkung in Form der Änderung der Ansprüche ist aus dem Gebrauchsmustergesetz (§ 15 Abs. 3 Satz 2) nicht übernommen worden, da für die Anmeldung nach dem Entwurf nicht die Angabe von Ansprüchen vorgesehen ist.

4. In Absatz 4 werden die näheren Einzelheiten des Löschungsantrages bestimmt. Auch insoweit ist die entsprechende Vorschrift des Gebrauchsmustergesetzes übernommen worden (§ 16).

5. Durch Absatz 5 werden die verfahrensmäßigen Bestimmungen des Gebrauchsmustergesetzes über das Löschungsverfahren (§ 17), die Vorschriften über die Rechtsmittel und Rechtsmittelverfahren (§ 18) und über das Verhältnis zwischen Löschungs- und Verletzungsverfahren (§ 19) für entsprechend anwendbar erklärt.

6. Die Vorschrift des § 20 des Gebrauchsmustergesetzes über die Erteilung einer Zwangslizenz mit der Verweisung auf § 24 Abs. 1 und §§ 81 bis 91 und 110 bis 122 des Patentgesetzes ist in den Entwurf nicht übernommen worden, weil für die Erteilung einer Zwangslizenz an einem Schutzrecht einer Topographie kein rechtlicher Bedarf besteht. Der Schutz der Topographie gibt dem Berechtigten keinen absoluten Schutz. Jeder Dritte ist berechtigt, die geschützte Topographie auch ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers selbst geschäftlich zu erwerben, besitzen, gebrauchen oder auch zu nutzen. Die geschützte Topographie kann von jedem Dritten analysiert werden, der dann seinerseits das Ergebnis dieser Analyse in eine selbständig entwickelte oder sogar nachentwickelte Topographie übernehmen kann (sogenanntes „reverse engineering"). Diese Art Schutzrecht an einer Topographie hindert damit nicht die unabhängige Entwicklung von Topographien durch Dritte. Die unabhängig entwickelte oder die einer geschützten Topographie nachentwickelte Topographie muß, um selber Schutz zu genießen, nicht neu sein. Beim Topographieschutz kann folglich die Interessenlage, die bei absoluten Schutzrechten zu einer Zwangslizenz führen kann, nicht gegeben sein.

Zu § 9 (Schutzverletzung; Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie)

1. In § 9 werden in Umsetzung des Artikels 2 Abs. 1 der Richtlinie und in entsprechender Übernahme der Vorschriften des Gebrauchsmustergesetzes (§ 24) die an Schutzverletzungen anknüpfenden Sanktionen des Unterlassungs- und Schadensersatzanspruchs geregelt. Insoweit ist in vollem Umfang auf das Gebrauchsmusterrecht und die dazu entwickelten Rechtsgrundsätze zu verweisen.

2. Nach Artikel 7 Abs. 2 der Richtlinie sind die Mitgliedstaaten der EG verpflichtet, für die Zeit ab Aufzeichnung, also ab Fertigstellung der Topographie bis zur Entstehung des Schutzrechts den Berechtigten vor der arglistigen Nachbildung, geschäftlichen Verwertung oder Einfuhr der Topographie zu diesem Zweck durch unberechtigte Dritte zu schützen. In Betracht kommt hier der Zeitraum, in dem die Topographie noch nicht oder zumindest nur unter Vereinbarung der Vertraulichkeit von dem Berechtigten geschäftlich verwertet worden ist, da anderenfalls das Schutzrecht bereits entstanden wäre. Den von der Richtlinie geforderten Schutz bei arglistigem Verhalten eines Nichtberechtigten gewährleistet das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Die zu § 1 UWG entwickelten Rechtsgrundsätze der wettbewerbswidrigen Ausbeutung fremder Leistung und die sich daraus ergebenden Ansprüche sind bei den Verhandlungen über die Richtlinie als die typischen Anspruchsgrundlagen im Sinne des Artikels 7 Abs. 2 der Richtlinie angesehen worden. Außer Ansprüchen aus § 1 UWG können auch vertragsrechtliche Ansprüche und gegebenenfalls auch Ansprüche wegen Verletzung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und anvertrauten Unterlagen (§§ 17, 18 UWG) in Betracht kommen. Einer ausdrücklichen Regelung in dem Entwurf bedarf es daher insoweit nicht.

Zu § 10 (Strafvorschriften)

In § 10 wird in Anlehnung an die entsprechenden Strafvorschriften des Gebrauchsmustergesetzes (§ 25) die Schutzrechtsverletzung unter Strafe gestellt. Die Abweichung von § 25 des Gebrauchsmustergesetzes ist rein redaktioneller Art.

Es erscheint gerechtfertigt, vorerst auch die Strafdrohung von einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe aus der geltenden Fassung der Vorschrift des § 25 des Gebrauchsmustergesetzes zu übernehmen. Ob diese Strafdrohung bei Straftaten im Bereich des Patent-, Gebrauchsmuster- und nunmehr auch

des Halbleiterschutzgesetzes verändert werden soll, soll im Zusammenhang mit einer umfassenden Neuregelung des Strafrechtsschutzes gegen die sogenannte Produktpiraterie entschieden werden, die derzeit vorbereitet wird. In diesem Zusammenhang soll geprüft werden, ob jedenfalls für schwerwiegende Fälle die Strafe verschärft werden soll.

Zu § 11 (Anwendung von Vorschriften des Patentgesetzes und des Gebrauchsmustergesetzes)

1. Die Verweisungen auf die Vorschriften des Patentgesetzes in Absatz 1 betreffen die Möglichkeit der Erstattung von Gutachten (§ 29 Abs. 1 und 2) und das Verfahren vor dem Deutschen Patentamt und dem Bundespatentgericht. Es sollen — wie in § 21 Abs. 1 des Gebrauchsmustergesetzes — die Vorschriften der §§ 123 bis 128 des Patentgesetzes mit Ausnahme von § 125 des Patentgesetzes entsprechend anwendbar sein, der die Anforderung entgegengehaltener Druckschriften in Nichtigkeitsverfahren wegen mangelnder Neuheit der Erfindung regelt.

2. In Absatz 2 werden die Vorschriften des § 21 Abs. 2, § 22 und der §§ 26 bis 30 des Gebrauchsmustergesetzes für entsprechend anwendbar erklärt. Insoweit soll im vollen Umfang auf das Gebrauchsmusterrecht und die dazu entwickelten Rechtsgrundsätze verwiesen werden.

II. Zum Zweiten Abschnitt (Änderung der Gesetze auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes)

Zu den §§ 12 (Änderung des Fünften Gesetzes zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes), 14 (Änderung der Patentanwaltsordnung) und 15 (Änderung des Gesetzes über die Beiordnung von Patentanwälten bei Prozeßkostenhilfe)

1. Durch die §§ 12, 14 und 15 werden die genannten Gesetze auf Topographieschutzsachen erweitert. Es wird damit bestimmt, daß den Patentanwälten und den übrigen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes zur Vertretung berechtigten Personen, insbesondere den Erlaubnisscheininhabern, auch in Topographieschutzangelegenheiten die Beratung und Vertretung übertragen werden kann. Da es sich bei dem Schutz der Topographie um ein gewerbliches Schutzrecht handelt, werden die beruflichen Aufgabenbereiche der bisher in diesen Angelegenheiten zur Vertretung berechtigten Personen um die Topographieschutzsachen erweitert (z. B. für die Patentanwälte in § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Patentanwaltsordnung). Daraus ergeben sich die übrigen Änderungen in der Patentanwaltsordnung, dem Gesetz über die Beiordnung von Patentanwälten bei Prozeßkostenhilfe und dem Fünften Überleitungsgesetz.

2. Des weiteren sind in der Patentanwaltsordnung die durch die neue Paragraphenfolge der Neufassung des Gebrauchsmustergesetzes unstimmig gewordenen Verweisungen auf die Vorschriften des Gebrauchsmustergesetzes bereinigt worden.

Zu § 13 (Änderung des Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts)

1. Durch die Nummern 1, 2 und 4 werden in § 6 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes und in den Nummern 120 000 ff. (Gebrauchsmustersachen vor dem Deutschen Patentamt) und 220 000 ff. (Gebrauchsmustersachen vor dem Bundespatentgericht) des Gebührenverzeichnisses die durch die Neufassung des Gebrauchsmustergesetzes unstimmig gewordenen Verweisungen auf die Vorschriften des Gebrauchsmustergesetzes bereinigt.

2. a) Durch Nummer 3 werden nach den Nummern 140 000 ff. (Musterregistersachen vor dem Deutschen Patentamt gemäß Artikel 2 Nr. 1 des Gesetzes zur Änderung des Geschmacksmustergesetzes vom 12. Dezember 1986, BGBl. I S. 2501) des Gebührenverzeichnisses die Nummern 150 000 ff. für Topographieschutzsachen vor dem Deutschen Patentamt in das Gebührenverzeichnis eingefügt. Für das Schutzrecht wird eine einmalige, als Anmeldegebühr zu zahlende Gebühr in Höhe von 500 DM für die gesamte Schutzdauer von zehn Jahren erhoben. Diese Gebühr soll die Kosten für die Anmeldung und die Verwaltung des Schutzrechts während der zehn Jahre abdecken. Die Regelung folgt der Vorschrift des Artikels 4 Abs. 4 der Richtlinie, nach dem die Mitgliedstaaten für die Eintragung des Schutzrechts und die Hinterlegung der Unterlagen nur die Zahlung der Gebühren in der Höhe vorsehen dürfen, die ihre Verwaltungskosten nicht überschreiten; damit soll sichergestellt werden, daß der Zugang zu diesem Recht nicht durch prohibitive Gebühren erschwert wird.

   Die einmalige Gebühr des Entwurfs ist für die gesamte Schutzdauer vorgesehen, da die hauptsächlichen Verwaltungsarbeiten des Deutschen Patentamts bis zur Eintragung entstehen. Eine zeitliche Staffelung der Gebühren in Verbindung mit Schutzrechtsverlängerungen sieht der Entwurf nicht vor. Diese im Patent- und Gebrauchsmusterrecht geltende Regelung dient vorrangig dem Zweck, den Schutzrechtsinhaber zu der Prüfung zu veranlassen, ob er das Schutzrecht aufrechterhalten will. Damit soll erreicht werden, daß im Interesse der Allgemeinheit nur solche Schutzrechte bestehen bleiben, die sich als wirtschaftlich wertvoll erwiesen haben. Dieses Allgemeininteresse an einem durch Schutzrechte nicht eingeschränkten möglichst freien Wettbewerb greift bei dem Schutz der Topographie als bloßem Nachbildungsschutz nicht durch. Der Schutz einer Topographie behindert den freien Wettbewerb nicht, da jeder Dritte eigenständige Topographien schaf-

fen kann, ohne durch andere geschützte Topographien daran gehindert zu sein. Es ist lediglich untersagt, die geschützte Topographie eines Dritten schlicht nachzubilden. Das Interesse an einer schlichten Nachbildung einer fremden Topographie ist aber nicht schutzwürdig.

b) Für die sonstigen Anträge (Änderung in der Person des Rechtsinhabers und Antrag auf Löschung) sind die entsprechenden Gebühren für Gebrauchsmustersachen übernommen worden, weil insoweit mit einem vergleichbaren Verwaltungsaufwand zu rechnen ist.

3. Mit Nummer 5 werden die Nummern 240 000ff. des Gebührenverzeichnisses den Musterregistersachen vor dem Bundespatentgericht zugeordnet, wie dies schon durch Artikel 2 Nr. 2 des Gesetzes zur Änderung des Geschmacksmustergesetzes vom 12. Dezember 1986 vorgesehen ist. Der Entwurf enthält insoweit keine Änderung. Bereinigt wird das Gebührenverzeichnis nur insoweit, als diese Nummern bereits durch § 43 Abs. 3 des Sortenschutzgesetzes vom 11. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2170) für Sortenschutzsachen vor dem Bundespatentgericht vergeben worden waren. Die Sortenschutzsachen vor dem Bundespatentgericht werden durch den Entwurf nunmehr aus systematischen Gründen als Nummern 260 000ff. in dem Gebührenverzeichnis geführt (siehe unten zu Nummer 7).

4. Mit Nummer 6 werden nach den Nummern 240 000ff. die Nummern 250 000ff. in das Gebührenverzeichnis für Topographieschutzsachen vor dem Bundespatentgericht eingefügt. Die Gebühren für die Erhebung der Beschwerde gegen Entscheidungen der Topographiestelle und der Topographieabteilung entsprechen der Höhe nach den Gebühren in Beschwerdeverfahren nach dem Gebrauchsmustergesetz. Es ist davon auszugehen, daß insoweit vergleichbare Arbeitsbelastungen auf das Bundespatentgericht zukommen werden, so daß es angemessen erscheint, die Gebühren in derselben Höhe festzusetzen.

5. Durch Nummer 7 werden aus systematischen Gründen für die Sortenschutzsachen vor dem Bundespatentgericht die Nummern 260 000ff. des Gebührenverzeichnisses vergeben (siehe oben Begründung zu Nummer 5).

Zu § 16 (Gesetz über die Erstattung von Gebühren des beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchsmuster- und Sortenschutzsachen)

Durch § 16 wird die Erweiterung des beruflichen Aufgabenbereichs der Patentanwälte auf die Topographieschutzsachen in dem Gesetz über die Erstattung von Gebühren des beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchsmuster- und Sortenschutzsachen berücksichtigt. Dabei orientieren sich die Gebühren voll an den Gebühren für Gebrauchsmustersachen. Es erscheint sachgerecht, wegen des vergleichbaren Arbeitsaufwandes den beigeordneten Patentanwälten Gebühren in derselben Höhe zuzuerkennen.

III. Zum Dritten Abschnitt (Änderung anderer Gesetze)

Zu § 17 (Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb)

Mit der in § 17 vorgesehenen Änderung des § 22 sollen in dieser Vorschrift, die zuletzt durch Artikel 4 Nr. 6 des Zweiten Gesetzes zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität vom 15. Mai 1986 (BGBl. I S. 721) geändert worden ist, ohne jede sachliche Änderung zwei Redaktionsversehen bereinigt werden.

1. Das erste Redaktionsversehen hat sich ergeben, als durch Artikel 139 Nr. 11 Buchstabe b des Gesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469) die im seinerzeitigen § 22 Abs. 2 Satz 2 noch enthaltene Verweisung auf den damaligen § 8 UWG gestrichen und dabei übersehen wurde, daß auch eine Anpassung des Wortes „der" erforderlich war. Dieser Irrtum soll durch das in Nummer 1 vorgesehene Ersetzen des Wortes „der" durch das Wort „des" bereinigt werden.

2. Das zweite Redaktionsversehen hat sich bei der Änderung des UWG durch das Gesetz zur Änderung wirtschafts-, verbraucher-, arbeits- und sozialrechtlicher Vorschriften vom 25. Juli 1986 (BGBl. I S. 1169) dadurch ergeben, daß bei den Beratungen über dieses Gesetz, die zum Teil gleichzeitig mit den Beratungen über das Zweite Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität stattfanden, übersehen worden ist, daß § 22 UWG, der nicht Gegenstand des Änderungsentwurfs war, noch auf die alte Fassung des § 13 UWG Bezug nimmt. Auch nach der in Nummer 2 vorgeschlagenen ausschließlich redaktionellen Änderung soll es dabei verbleiben, daß wie schon im bisherigen Recht die nunmehr in § 13 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 UWG bezeichneten Gewerbetreibenden, Verbände und Kammern das Recht haben, Strafantrag zu stellen und Privatklage zu erheben.

Zu § 18 (Änderung der Zugabeverordnung)

Mit der in § 18 vorgesehenen Änderung des § 2 Abs. 1 der Zugabeverordnung soll ein Druckfehler, der in Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung wirtschafts-, verbraucher-, arbeits- und sozialrechtlicher Vorschriften vom 25. Juli 1986 (BGBl. I S. 1169) enthalten ist (Ziffer 3 statt Ziffer 2), berichtigt werden. Dieser Druckfehler kann im Wege der üblichen formlosen Berichtigung im Bundesgesetzblatt nicht beseitigt werden, weil er sich bereits bei der Einbringung des Entwurfs des Änderungsgesetzes aus der Mitte des Bundestages eingeschlichen hatte. Auch hier soll es ebenso wie bei Verstößen gegen das Rabattgesetz dabei bleiben, daß wie im bisherigen Recht die Befugnis zur Klageer-

hebung bei Verstößen gegen die Zugabeverordnung den nunmehr in § 13 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 UWG bezeichneten Gewerbetreibenden, Verbänden und Kammern zusteht.

Zu den §§ 19 bis 25

Durch die §§ 19 **(Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes)**, 20 **(Änderung des Rechtspflegergesetzes)**, 21 **(Änderung des Rechtsberatungsgesetzes)**, 22 **(Änderung der Strafprozeßordnung)**, 23 **(Änderung der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte)**, 24 **(Änderung des Bewertungsgesetzes)** und 25 **(Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen)** soll das neue gewerbliche Schutzrecht an den Topographien von Halbleitererzeugnissen in die genannten Gesetze aufgenommen werden. Der Entwurf orientiert sich insoweit an den Regelungen für Gebrauchsmustersachen. Sowohl bei der Regelung der Zuständigkeit in Strafsachen, soweit es sich um Geheimanmeldungen handelt, als auch bei der Übertragung einzelner Aufgaben auf den Rechtspfleger in Verfahren vor dem Patentgericht sind die entsprechenden Regelungen für Gebrauchsmustersachen auf die Topographieschutzsachen wörtlich übernommen worden. In dem Rechtsberatungsgesetz, der Strafprozeßordnung, der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte, dem Bewertungsgesetz und dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen sind jeweils nach den Gebrauchsmustersachen die Topographieschutzsachen eingefügt worden. In der Strafprozeßordnung und der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte sind zusätzlich die durch die neue Paragraphenfolge der Neufassung des Gebrauchsmustergesetzes unstimmig gewordenen Verweisungen auf die Vorschriften des Gebrauchsmustergesetzes bereinigt worden.

IV. Zum Vierten Abschnitt (Übergangs- und Schlußvorschriften)

Zu § 26 (Übergangsvorschriften)

In § 26 wird bestimmt, daß Schutz nur für die Topographien in Anspruch genommen werden kann, die nicht länger als zwei Jahre vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht nur vertraulich geschäftlich verwertet worden sind. Dabei wird jedoch klargestellt, daß Rechte nur für die Zeit ab Inkrafttreten dieses Gesetzes geltend gemacht werden können. Handlungen Dritter vor Inkrafttreten dieses Gesetzes, die eine Schutzrechtsverletzung darstellen würden, können keine Sanktionen auslösen. Der Berechtigte kann die Verwertung der von ihm geschaffenen Topographie durch einen Dritten erst mit Wirkung ab Inkrafttreten dieses Gesetzes untersagen. Von diesem Zeitpunkt an kann er auch Entschädigung nach § 6 Abs. 3 Satz 2 oder Unterlassung der weiteren Verletzungshandlungen und Schadensersatz nach § 9 verlangen.

Zu § 27 (Berlin-Klausel)

Diese Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel.

Zu § 28 (Inkrafttreten)

Diese Vorschrift bestimmt für das Inkrafttreten den 1. November 1987. Das Gesetz muß nach der Richtlinie (Artikel 11 Abs. 1) spätestens bis zum 7. November 1987 in Kraft treten. Die Richtlinie sieht diese ungewöhnlich kurze Umsetzungsfrist vor, damit europäischen Anmeldern in den USA Gegenseitigkeit gewährt werden kann (17 USC § 902 [a] [2]).

Anlage 2

Stellungnahme des Bundesrates

1. **Zum Gesetzentwurf insgesamt**

   Der Bundesrat begrüßt ausdrücklich, daß die Bundesregierung die Ratsrichtlinie über den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen zügig in deutsches Recht umsetzt.

   Er bittet die Bundesregierung, im Zuge des weiteren Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen, inwieweit das Geschäfts- und Betriebsgeheimnis deutscher Halbleiterhersteller wirksamer geschützt werden kann und insbesondere die Herausgabe von Vervielfältigungsstücken beim Patentamt, die sich auf kodierte Informationen, Computerausdrucke mit Koordinaten und Dimensionierungsangaben beziehen, verhindert werden kann.

   Es sollte ferner geprüft werden, ob in dieser Hinsicht Regelungen, wie sie in den USA und Japan praktiziert werden, ebenfalls in den Gesetzentwurf eingebracht werden können.

2. **Zu § 2 Abs. 4 Satz 1**

   § 2 Abs. 4 Satz 1 ist wie folgt zu fassen:

   „Das Recht auf den Schutz der Topographie steht unbeschadet der Absätze 1 und 2 auch demjenigen zu, der die Topographie aufgrund eines ausschließlichen Rechts zur geschäftlichen Verwertung in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft erstmals in einem ihrer Mitgliedstaaten nicht nur vertraulich geschäftlich verwertet und die Voraussetzungen des Absatzes 3 erfüllt."

   Begründung

   Anpassung an Artikel 3 Abs. 4 Buchstabe b der Richtlinie vom 16. Dezember 1986.

3. **Zu § 2 Abs. 6 Nr. 2**

   In § 2 Abs. 6 Nr. 2 sind die Worte „deutschen Staatsangehörigen" durch die Worte „Deutschen im Sinne des Grundgesetzes" zu ersetzen.

   Begründung

   Durch die Formulierung „deutschen Staatsangehörigen" würden diejenigen Personen nicht von der Regelung in § 2 Abs. 6 Nr. 2 erfaßt werden, die nach Artikel 116 GG Deutsche sind, aber nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

4. **Zu § 4 Abs. 2**

   In § 4 Abs. 2 ist das Klammerzitat „(§ 8 Abs. 1 bis 4)" durch das Klammerzitat „(§ 8 Abs. 2 bis 4)" zu ersetzen.

   Begründung

   Klarstellung des Gewollten.

5. **Zu § 4 Abs. 4 Satz 3 und § 8 Abs. 5**

   Die Worte „, über die Rechtsmittel und Rechtsmittelverfahren (§ 18)" sind in § 8 Abs. 5 zu streichen und in § 4 Abs. 4 Satz 3 nach der Angabe „(§ 10)" einzufügen.

   Begründung

   Redaktionelle Klarstellung.

6. **Zu § 22**

   § 22 ist wie folgt zu fassen:

   ‚§ 22

   Änderung der Strafprozeßordnung

   In § 374 Abs. 1 Nr. 8 der Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074) wird nach der Angabe „§ 25 des Gebrauchsmustergesetzes," die Angabe „§ 10 des Halbleiterschutzgesetzes," eingefügt.'

   Begründung

   Redaktionelle Richtigstellung.

Druck: Bonner Universitäts-Buchdruckerei, 5300 Bonn
Alleinvertrieb: Verlag Dr. Hans Heger, Postfach 20 08 21, Herderstraße 56, 5300 Bonn 2, Telefon (02 28) 36 35 51
ISSN 0722-8333